

Title	赤外域スピン・フリップラマンレーザーに関する研究
Author(s)	安田,和人
Citation	大阪大学, 1982, 博士論文
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/1635
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

赤外域スピン・フリップ ラマン

レーザーに関する研究

1981

安田和人

第	1	章	序	論	i ••••	• • • • • • • •	 1
			*	考	文	献	 4

次

B

第2	章		n ·	- 1	[n	S	b	ス	ピ	ン	•	フ	リッ	,7	7°	ラ	マ	ン	(S I	F :	R)	L	/ -	・ザ			
	§	2.	1	j	緒		言		•••	•••	••••	••••	•••	• • • •	•••	•••	•••	••••	•••	••••	••••	• • • •	•••	••••	•••		•••••	6
	§	2.	2		\mathbf{S}	\mathbf{F}	\mathbf{R}	ν		ザ		Ø	原	理		•••	•••	••••	••••	••••		• • • •	•••	••••	•••	••••		6
	§	2.	3	4	実	験	装	置	及	び	実	験	方	法	•••	•••	•••		••••	••••		• • • •		••••	•••	••••		15
	§	2.	4		s	\mathbf{F}	R	ν		ザ	_	出	力	Ø	励	起	光	強	度	依	存	性	••	• • • •	•••			15
	§	2.	5		s	\mathbf{F}	R	ν		ザ		出	力	Ø	磁	場	依	存	性									
			2.	5.	1		Π	調	特	性	•		•••	••••	•••	•••	•••	• • • •	••••		•••		•••	••••	••••	••••		16
			2.	5.	2		出	力	光	Ø	磁	場	依	存	性		••••	•••	••••	• • •	•••	• • • •	•••	•••	••••	••••	• • • •	18
			2.	5.	3		出	カ	Ø	磁	場	依	存	性	Ø	解	析		••••	•••	••••	• • • •	• • •	• • • •	•••	••••	•••••	20
	§	2.	6	:	結		言			••••	••••	••••	•••		• • • •	•••	•••	••••	••••	••••		• • • •	• • •	· • • •	•••	••••		23
		参		考		文		献		••••	•••	••••	•••	••••	• • • •	•••	•••	••••	••••	••••	••••	• • • •	• • •	••••	•••	••••	•••••	24

第3章 n-Pb0.88Sn0.12Te SFRレーザー § 3.1 § 3. 2 § 3. **3** 実験装置及び実験方法 3. 3. **1** 3. 3. **2** § 3.4 SFRレーザー出力の励起光強度依存性 ……………28 § 3.5 SFRレーザー出力の磁場依存性 3. 5. 1 3. 5. **2** 出力の磁場依存性………………………………………30 3.5.3 出力の磁場依存性の解析 ………35

§	3.	6	今	·後⊄	問題点		•••••	• • • • • •	••••	••••••	•••••	• • • • • • • •	••••••	• • • •	38
§	3.	. 7	新		言	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • •	•••••••	• • • •	38
	参	:	考	文	献…	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • •	•••••••	• • • •	40

第4	章		n — I	nSb	SFRレーザー出力及び励起光透過波形の時間的変化	L
	§	4.	1	緒	言	42
	§	4.	2	S F	Rレーザー出力及び励起光透過特性の時間的変化	
			4. 2.	. 1	実験装置及び実験方法	43
			4. 2.	. 2	実験結果と検討	44
	§	4.	3	CO_2	レーザー光による光電導特性	
			4. 3.	. 1	実験装置及び実験方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
			4. 3.	. 2	実験結果と検討	47
	§	4.	4	結	言	50
		参	考	文	献	52

第5章	S F	Rν-	ーザー	のガス	《分析	斤への	応用					
§ 5	. 1	緒言	i	••••••	••••••	•••••	••••••	•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • •	53	
§ 5	. 2	実験力	与法…	••••••	••••	•••••	•••••	•••••	•••••••	• • • • • • • • • • • •	53	
§ 5	. 3	実験糹	吉果 と	検討	••••	••••	••••••	•••••	•••••••	••••••••	54	
§ 5	. 4	結言	i	••••••	••••	••••••	••••••	•••••	•••••••	• • • • • • • • • • •	··· 5 7	
参	》 考	文	献…	••••••	••••	•••••	••••••	•••••	•••••••	• • • • • • • • • • • • •	58	

第	6	章	結	論		60
謝				辞	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62
研		究	業	績		63

第1章 序 論

1950年代末に発明されたレーザーは、単色、高輝度、高指向性という従来の光源にないすぐれた特性をもつため、以後の物理学・工学の発展に大きな寄与をしたばかりでなく、新らしい研究分野も開拓してきた。非線形光学はその一つであるが、最初は水晶を媒質とするルビーレザー光の第2高調波の発生から発展し始めた。初期には電気的な絶縁体が媒質として用いられていたが第2高調波の発生には媒質中の価電子が重要な寄与をする事が明らかにされた。その後間もなく、固体中の伝導電子も非線形光学効果を生じる可能性があることが指摘され、半導体結晶がこの効果を観測する媒質として注目され始めた。その理由は、半導体結晶は禁制帯幅以下のフォトンエネルギーをもつ光に対して透明であり、また、伝導電子密度を10¹⁴~10¹⁶cm⁻³という非線形光学効果を観測するのに最適な値に整えることが可能なためである。半導体結晶を媒質として用いて、伝導電子によるラマン散乱⁽¹⁾、多光子混合⁽²⁾、遠赤外光の発生⁽³⁾、自己収束効果⁽⁴⁾の研究が行なわれている。⁽⁵⁾

一方、この非線形光学効果を利用して、電界あるいは磁界に対して同調可能な散乱光を得ようと する研究も行なわれ始めた。その一つに強磁場を印加した半導体中の伝導電子によるラマン散乱が ある。この場合には磁場によって散乱光周波数を連続的に変化できるという特徴がある。以下磁場 中の伝導電子によるラマン散乱の研究の歴史を振り返ってみる。

磁場中での伝導電子によるラマン散乱は1966年MITのWolffにより最初に予言された⁶彼 は伝導体の nonparabolicity に基づく非調和効果が存在すると、ランダウ準位間での伝導電子 のラマン散乱が可能になることを示した。また、彼は InSb のような禁制帯幅の小さい半導体では 伝導電子の有効質量が小さく、伝導電子の nonparabolicity が大きいため、ラマン散乱断面積が 大きくなることも指摘した。

その後、Bell研究所のYafetはゼーマン副準位間でのスピン反転を伴うラマン散乱(Spin Flip Raman散乱:SFR散乱)の可能性を指摘した。⁽⁷⁾ これらの過程の実験的な確認は、1967 年にBell研究所のSlusher らによって最初に行なわれ、n-InSbを媒質としCO₂レーザー光 を励起光源とするゼーマン準位間のSFR散乱光及びランダウ準位間のラマン散乱光が観測された⁽⁸⁾ 1969年、Heriot-Watt大学のWherrettらはSFR散乱の散乱断面積は、散乱に寄与する電子 の初期状態と終状態の分布差に依存することを指摘し、散乱に寄与する伝導電子がすべて初期状態 に分布するようになる時、散乱強度が最も強くなることを理論的に指摘した。⁽⁹⁾ この散乱強度が最 大となる条件のもとで、1970年にBell研究所のPatelとShawはQスイッチCO₂レーザーを 励起光源とするn-InSb SFRレーザーの発振に成功し、同時にSFRレーザーの発振線幅が非常に狭 く、励起光からSFRレーザー光への変換効率も1%程度と高い事を明らかにした。

その後、1971年にMITのAggarwalらはTEA CO₂ レーザーを励起光源とする、最大出力1kW以上の大出力SFRレーザーを発振させた。⁽¹⁾ 彼らは共振器の光励起領域を大きくする

-1-

ことによって大出力を得ることに成功した。

以上述べてきたSFRレーザーは、いずれもパルス発振であったが、1971年にはMITの Mooradianらが最初のSFRレーザーの連続発振に成功した。⁽²⁾ 彼らは励起光源としてCOレ ーザーを用い、励起光のフォトンエネルギーをラマン媒質の禁制帯幅に近づけたときにラマン利得 が共鳴的に増加する効果(共鳴ラマン効果)を活用した。

このような、SFRレーザー開発の流れの中で近年波長10 μ m領域で動作するSFRレーザーの 開発が活発に行なわれている。このレーザーの実現のためには波長10 μ m領域のすぐれた光源であ るCO₂レーザー光に対して共鳴ラマン効果を期待できる材料をラマン媒質として使用する事が不可 欠である。この要求を満たし得る材料にはHg_{1-x}Cd_xTeやPb_{1-x}Sn_xTe等の三元混晶半導体 がある。現在すでにSattlerらによってHgCdTeを共振器としたSFRレーザーで連続発振が実 現されており⁽¹³⁾ PbSnTeにも連続発振に必要な共鳴効果が存在することがYasuda らによって 確認されている⁽¹⁴⁾ これらの材料は単にCO₂レーザー光に対して共鳴効果があるだけでなく、SFR 共振器として用いた場合には伝導電子の有効g値がInSbに比して大きいため、単位磁場当りの散 乱光の波長変化の大きさがInSbより大きくなるという利点もある。また、これらの材料は組成比 を変える事により禁制帯幅を変化できるためCO₂レーザー光よりも長波長の励起光に対しても共鳴 効果を活用し、SFRレーザーを構成できると考えられ、今後さらに発展が期待される。

SFRレーザーの可変波長範囲はn-InSbとCOレーザーの組合せでは 5.2~6.2 μ m の範囲で⁽¹⁵⁾ また、n-InSbとCO₂ レーザーの組合せでは 9 μ m~14.6 μ m⁽¹⁾程度となっている。但し、後者に は散乱光が再び励起光として作用することにより励起光からゼーマン準位間隔の2倍のエネルギー シフトをうけて散乱される出力光も含んでいる。SFRレーザーの可変波長範囲を拡大するため励 起光源として他のレーザーを使用する試みも行なわれている。この例としては CO₂ レーザー光によ って励起した NH₃ ガスレーザーを励起光源として使用した例があり、⁽¹⁶⁾可変波長範囲は 14~16.8 μ m と報告されている。今後、励起に用いる光源の開発と発展に伴い、SFRレーザーの波長可変 範囲はさらに拡大されると予想できる。

ー方、InSb SFRレーザーの発振線幅は CO₂レーザーのパルス励起の場合、単一縦モード発振では、 0.0 5 cm⁻¹以下と報告されている。⁽¹⁾ しかし、発振しきい値を十分超える励起光強度のもとでは 2本ないしは3本の縦モードが同時に発振するため実効的に発振線幅が広がって観測される。これ は共振器の電子密度が10⁶ cm⁻³ 程度と高いため、電子が伝導帯の nonparabolicity を反映して ラマン遷移を行う結果、ラマン利得のスペクトル幅が広がることによる。しかし、COレーザー励 起の場合には、共鳴効果を利用することによって、ラマン利得の増大をはかれるため、共振器中の 電子密度を減少することが可能となり発振線幅を大きく低減できる。実際1×10⁵ cm⁻³の電子密度の共 振器を用いた場合、発振線幅は1 kHz以下と報告されている。⁽¹⁾ また、連続発振のSFRレーザー では共振器に印加する磁場を精密に制御し、出力の周波数ゆらぎを 30 kHz 以下にする試みも行な われている。⁽¹⁴⁾ SFRレーザーを一定波長で発振させる時には、このような安定性が実現できるが

- 2 -

発振波長を掃引する場合には共振器の縦モードとラマン利得幅の相互作用によって発振波長に非連続 な跳び (mode jump)が生じる。⁽¹⁹⁾ しかし、表面に無反射コーティングを施した n-InSb 結晶 をラマン利得領域とし、サーボ制御系によって結晶外部に設置した反射鏡間隔を可変とした SFR レーザーではモードの跳びを完全に防止できたという報告がある。⁽²⁰⁾

励起光からSFRレーザー出力(ストークス光)へのバワー変換効率はCO₂レーザー励起の場合 最大で5%程度、または最大出力は1kW程度である。⁽¹⁾しかし、共鳴効果を活用した連続発振では 変換効率は約80%にも達し、出力も2~3W程度と報告されている。⁽²⁾最近CO₂レーザー励起の n-InSbSFRレーザーで非線形な光吸収が発生することが指摘されている。SFRレーザーの発振出力は励起光強度が発振しきい値を超えると急激に増加しピークに達するが、その後は励起強度の増加と共に出力はかえって減少するようになる。また、出力の時間的な変化は励起光バルスと相似な変化を示さず励起光強度がピークとなる時にはかえって減少することが見出されている。⁽²⁾この現象が生じる原因は励起光によって価電子帯から伝導体に電子が励起され、その結果生じた正孔によって励起光が吸収されるためであることが明らかになった。⁽²⁾

SFRレーザーは以上に述べた特性をもった光源であるが、このレーザーの波長可変範囲に は従来強力な光源がなかったため、このレーザーの分光学的な応用や光化学反応用光源としての応 用に興味がもたれている。これまでに行なわれたSFRレーザーによる分光実験には水蒸気のラム くぼみ幅の測定⁶⁴や大気中のNO_XやO₂等公害ガス濃度の長時間測定⁶³等の例がある。また、光化 学反応への応用としてはNH₃レーザーを励起光源とするSFRレーザーをUF₆の同位体分離に用い る事が提案されている。 その他、SFRレーザーの出力光と励起光を光混合し、これら二つ の差周波光として遠赤外光を取り出す試みも行なわれている。 つこの場合、励起光としてCO₂レー ザーを用いると遠赤外光の可変波長範囲は85 μ m~105 μ m 程度となることが報告されている。

以上述べたようなSFRレーザーの研究経過の中で、筆者は主としてCO₂レーザーを励起光源と しn-InSb及びn-PbSnTeを共振器とするSFRレーザーの基礎発振特性を明らかにし、さら にその特性をもとにSFRレーザーを高分解能スペクトロスコピーに応用することを目的として研 究を行ってきた。本論文第2章では、n-InSbSFRレーザーの基礎発振特性について述べる。 このレーザー出力の磁場による変化は従来厳密に解析されていなかったが、実験結果がSFR利得 と共振器内部の光損失を考慮した解析とよく一致する事を示す。第3章では、波長10 μ m領域で連 続発振が期待できるn-PbSnTeSFRレーザーをはじめて開発して得た基礎発振特性について述 べる。このレーザーには連続発振を実現するため必要な共鳴効果が存在することを実験的に明らか にし、計算値と対比する。第4章では、n-InSbSFRレーザーの出力及び透過光波形の時間的 な変化について述べ、これらを決定する要素として励起光によって生成される正孔の寄与を論じる。 第5章では、n-InSbSFRレーザーの応用としてNH₃ガス吸収スペクトルを測定した結果につい て述べる。第6章では、2章から5章までの結論を述べ本論文を終結する。

- 3 -

参考文献

- A.Mooradian and G.B.Wright; Phys. Rev. Letters <u>16</u> (1966) 999.
- C.K.N.Patel, R.E.Slusher and P.A.Fleury; Phys. Rev. Letters 17 (1966) 1011.
- V.T.Nguyen and T.J.Brides; Phys. Rev. Letters <u>29</u> (1972) 359.
- N.Tzoar and J.I.Gersten; Phys. Rev. Letters <u>26</u> (1971) 1634.
- 5) 矢島達夫;量子エレクトロニクス(上),物理学選書13巻,裳華房(1972)
- 6) P.A.Wolff; Phys. Rev. Letters <u>16</u> (1966) 225.
- 7) Y.Yafet; Phys. Rev. 152 (1966) 858.
- R.E.Slusher, C.K.N.Patel and P.A.Fleury; Phys. Rev. Letters <u>16</u> (1967) 77.
- 9) B.S.Wherrett and P.G.Harper; Phys. Rev. 15 (1969) 692.
- 10) C.K.N.Patel and E.D.Shaw; Phys. Rev. Letters <u>24</u> (1970) 451.
- 11) R.L.Aggarwal, B.Lax, C.E.Chase, C.R.Pidgeon and D.Limbert; Appl. Phys. Letters 18 (1971) 383.
- 12) A.Mooradian, S.R.J.Brueck and F.A.Blum; Appl. Phys. Letters <u>17</u> (1970) 481.
- 13) J.P.Sattler, B.A.Weber and J.Nemarich; Appl. Phys. Letters <u>25</u> (1974) 491, <u>27</u> (1975) 93.
- 14) K.Yasuda and J.Shirafuji; Appl. Phys. Letters <u>34</u> (1979) 661.
- 15) C.K.N.Patel, E.D.Shaw and R.J.Kerl; Phys. Rev. Letters <u>25</u> (1970) 8.

- 16) C.K.N.Patel, T.Y.Chang and V.T.Nguyen; Appl. Phys. Letters <u>28</u> (1976) 603.
- 17) C.K.N.Patel; Phys. Rev. Letters 28 (1972) 649.
- 18) S.R.J.Brueck and A.Mooradian; IEEE J. Quantum. Electron <u>QE-10</u> (1974) 634.
- S.R.J.Brueck and A.Mooradian; Appl. Phys. Letters
 <u>18</u> (1971) 229.
- 20) T.Scragg, C.N.Ironside, R.B.Dennis and S.D.Smith; Opt. Commun. <u>18</u> (1976) 456.
- 21) C.S.DeSilets and C.K.N.Patel; Appl. Phys. Letters <u>22</u> (1973) 543.
- 22) J.F.Figueira, C.D.Cantrell, J.P.Rink and P.R.Forman; Appl. Phys. Letters <u>28</u> (1976) 398, 442.
- 23) K.Yasuda and J.Shirafuji; Jpn. J. Appl. Phys. (submitted)
- 24) C.K.N.Patel; Appl. Phys. Letters 25 (1974) 112.
- 25) C.K.N.Patel; Opt. and Quantum Electron 8 (1976) 145.
- 26) K.Boyer; "Laser Isotope Separation", 'Laser Photochemistry, Tunable Laser and Other Topics' (ed S.F.Jacobs et al., Addison-Wesley,London, 1976) p. 1.
- 27) T.J.Bridges and V.T.Nguyen; Appl. Phys. Letters <u>23</u> (1973) 107.
- 28) N.Brignall, R.A.Wood, C.R.Pidgeon and B.S.Wherrett; Opt. Commun. <u>12</u> (1974) 17.

第2章 n-InSb スピン・フリップ ラマン(SFR)レーザー

§ 2.1 緒 言

波長10µm領域で動作する $CO_2 \nu$ ーザー励起n-InSb SFR ν ーザーは、Patel らによって最 初に実現された。⁽¹⁾ このSFR ν ーザーの可変波長領域には、従来強力な出力をもつ光源が数少なかった 反面、公害のもととなる各種のガスをはじめ、多くのガス分子の特徴的な吸収スペクトル帯(Fin ger Print帯)が存在することから、このレーザーをこれからガス分子の吸収スペクトル測定等 のスペクトロスコピー用の光源として利用することが注目されてきた。また、このレーザーの出力 はバルス発振となるが、そのピーク出力は共振器中の励起体積を大きくする事により容易に増大す ることが可能で、1kW以上に達する大出力も得られている。⁽²⁾⁽³⁾ このように大出力化が可能なこ とから、最近では光化学反応用光源としての応用も注目されはじめ、レーザー同位体分離用の光源 の有力候補の1つとされている。⁽⁴⁾ SFRレーザーの発振開始磁場及び出力は共振器中に含まれる 伝導電子密度によって影響されるが、近年、結晶成長技術の進歩により、n-InSb の電子密度の 制御が可能となりSFRレーザー共振器として最適な結晶が得やすくなったことから、このレーザ ーの実用性は急速に高まっている。

本章では横励起(TE)CO2 レーザーで励起したn-InSbSFRレーザーの基礎発振特性につい て述べる。2.2節ではSFRレーザーの原理として、特にその利得機構に影響を及ぼす諸要素を考察す る。2.3節ではSFRレーザーの実験条件について述べ、2.4、2.5節では基礎発振特性の測定か ら得られた発振出力の励起光強度依存性、出力の可変波長範囲、発振出力の磁場による変化につ いて述べる。

以上、本実験で得られたSFRレーザーの発振出力がどのような要素により影響をうけるかを考察し、CO2レーザー励起SFRレーザーの基礎発振特性を明らかにする。

§2.2 SFRレーザーの原理

n形半導体に磁場を印加すると伝導電子は磁場に垂直な面内でサイクロトロン運動を行なう。こ の時、磁場に垂直な方向の運動に対する運動エネルギーは磁場が存在しない時のような準連続値と は異なり、サイクロトロンエネルギー $\hbar\omega_c$ ごとの飛び飛びの値となる。また、磁場の存在は伝導 電子がもつスピンに関する2重の縮退を解き、分裂した2つのエネルギー状態 (ゼーマン 副 準位)を出現させる。 このため、各々のサイクロトロンエネルギー $\hbar\omega_c$ で量子化されたエネルギ ー準位はそれぞれ2つづつの副準位(以下ではスピン準位とよぶ)に分裂することになる。 磁場 中での伝導電子のエネルギーは磁場方向を2軸にえらぶと

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{g} + \frac{\hbar^{2} \mathbf{k}_{z}^{2}}{2m^{*}} + (\ell + \frac{1}{2}) \hbar \omega_{c} - \frac{1}{2} |g^{*}| \cdot \mu_{B} \cdot \mathbf{B}$$

(2.2.1)

と表わされる。 $^{(5)}$ ここで、 E_{σ} は磁場が存在しない時の禁制帯幅、 m^{*} は伝導電子の有効質量、 k_{z} は電子波数の磁場方向成分、ℓはランダウ準位の量子数で0を含む正整数、g*は伝導電子の有効g 値、µR はボーア磁子、Bは磁場を表わす。また、一符号は磁場に平行なスピンに対応する準位 (↑スピン準位)に、十符号は反平行なスピンに対応する準位(↓スピン準位)にそれぞれ対応す る。また、この式から磁場中で電子がもつエネルギーは磁場方向の波数k。とランダウ準位量子数 ℓ及びスピンの向きによって指定されることがわかる。

H111-

SFRレーザーは通常 $\ell = 0$ のランダウ準位に付属 するゼーマン準位間、すなわち↑スピン準位と↓スピ ン準位の間での電子のラマン遷移に伴って放出される 散乱光を利用する。ラマン遷移をストークス光を例と して説明すると、図-2.2.1に示すように初期状態 | i> で表わされる↑スピン準位に存在する電子は励 起光光子エネルギーhω。を吸収することにより、中間 状態 | t > に遷移し、この中間状態から終状態 | f > で表わされる↓スピン準位に遷移する時散乱光として 光子エネルギーhω、をもつストークス光を放出する。 この初期状態と終状態のエネルギー差を hungとすると

 $\hbar\omega_{\mathbf{R}} = |\mathbf{g}^*| \ \mu_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}$ であり、励起光光子エネルギートω。と散乱光光子エネルギートω。との間には

 $\hbar \omega_{0} - \hbar \omega_{s} = \hbar \omega$

で表わされる関係が成立する。(2.2.2)式で表わされる周波数WRは磁場によって変化できるた め、散乱光の周波数は磁場により連続的に制御可能となる。 InSb では禁制帯幅が小さく、スピ ン軌道相互作用が非常に大きいことにより、伝導電子のもつ有効g値は大きい。このため散乱光の 単位磁場当りの周波数シフトも大きくなる。SFRレーザーではストークス光の他に励起光より WRだけ周波数の高い散乱光も観測される。この散乱光は反ストークス光とよばれ光子エネルギー をhW ASで表わすと

 $\hbar\omega_{0} - \hbar\omega_{AS} = -\hbar\omega_{R}$ (2.2.4) の関係が成立する。反ストークス光はストークス光発生に伴って電子が遷移し

ラマン散乱は3次の非線形光学効果であるが、ストークス光の利得g。は以下のように非線形 分極を含む非線形マクスウェル方程式を解く事により得られる。励起光とストークス光の 電界ベクトルをE₀,E₅で表わすと、ストークス光周波数O₅をもつ非線形分極 P^{NL}は3次の非線形 感受率XRにより



図-2.2.1 ストークスラマン散乱の機構

(2.2.2)

(2.2.3)

lt>

lf >

ħω。

$$P_{\rm s}^{\rm NL} = \chi_{\rm R} \cdot |E_{\rm o}|^2 \cdot E_{\rm s} \qquad (2.2.5)$$

と表わされる。ストークス光の電界はこの非線形分極を駆動項としてもつ非線形マクスウェル方程式

$$\nabla \times \nabla \times E_{\rm s} + \frac{\varepsilon_{\rm s}}{{\rm C}^2} \quad \frac{\partial^2 E_{\rm s}}{\partial {\rm t}^2} = -\frac{4\pi}{{\rm C}^2} \cdot \frac{\partial^2 P_{\rm s}^{\rm NL}}{\partial {\rm t}^2} \quad (2.2.6)$$

により表わされる。この(2.2.6)式の一次元解として

$$E_{s}(t.Z) = E_{s} \cdot \exp\{i(K_{s} \cdot Z - \omega_{s}t)\}$$
(2.2.7)

を仮定する。ここで K_{s} はストークス光波動ベクトルである。(2.2.6)と(2.2.7)式から K_{s} は

$$K_{\rm s}^{2} = \frac{\omega_{\rm s}^{2}}{{\rm C}^{2}} \cdot \varepsilon_{\rm s} \left(1 + \frac{4\pi}{\varepsilon_{\rm s}} \chi_{\rm R} \mid E_{\rm o} \mid^{2} \right)$$
(2.2.8)

と表わされる。この式はストークス光の分散関係を表わす。また、 XR は複素数となり

 $\chi_{\mathbf{R}} = \chi_{\mathbf{R}}' = \mathbf{i} \chi_{\mathbf{R}}''$

と表わされるが、SFR散乱では負の虚数値となる。⁽⁷⁾ (2.2.8)式の第2項は一般に小さいことにより K_s は

$$K_{\rm s} = \frac{\omega_{\rm s}}{\rm C} \, {\rm n}_{\rm s} - \, {\rm i} \, \frac{2\pi\omega_{\rm s}}{{\rm C}\,{\rm n}_{\rm s}} \, |E_{\rm o}|^2 \, \chi_{\rm R}^* \, (2.2.9)$$

と表わせる。これを(2.2.7)式に代入することにより、ストークス光の電界は

$$K_{\rm s} (\mathbf{t} \cdot \mathbf{Z}) = E_{\rm s} \exp\left\{\frac{2\pi \chi_{\rm R}^{"} \omega_{\rm s} |E_{\rm o}|^2}{Cn_{\rm s}} \cdot \mathbf{Z}\right\}$$

$$\times \exp \left\{ i \left(\frac{\omega_{s}}{C} n_{s} \cdot Z - \omega_{s} t \right) \right\}$$
 (2.2.10)

と表わされる。(2.2.10)式の指数第1項は正数であり、ストークス光電界は伝搬するにつれて 増幅されることを示している。

ストークス光の単位長当りの利得 gsは(2.2.10)式から

$$g_{s} = \frac{4 \pi \chi_{R}^{"} \omega_{s}}{n_{s}C} |E_{o}|^{2}$$

$$=\frac{8\pi^{2}\cdot\omega_{s}\chi_{R}^{*}}{C^{2}\cdot n_{s}n_{o}}I_{o} \qquad (2.2.11)$$

と表わされる。ここで I_o は励起光強度、 n_o は励起光周波数での媒質の屈折率を表わす。SFR散乱では励起光と散乱光に対する媒質の屈折率の変化が小さいため、 $n_s \simeq n_o$ と表わす。

ストークス光の利得 g_s は感受率 χ_R ["]を用いて表わすよりも媒質中の散乱体がもつ微分散乱断面積 積を用いて表わすほうが実用上便利である。Dennis らは媒質単位体積内に含まれた伝導電子に 対する単位立体角あたりの散乱断面積 ($d\sigma/dg$)_t は感受率の虚数項 χ_R ["]により

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\varrho}\right)_{\mathrm{t}} = \chi'' \left(\frac{\omega_{\mathrm{s}}}{\mathrm{C}}\right)^{4} \frac{\hbar\Gamma}{2} \frac{\mathrm{n}_{\mathrm{s}}}{\mathrm{n}_{\mathrm{o}}} \qquad (2.2.12)$$

と表わされる事を示している。⁸⁾ 但し、(2.2.1 2)式では感受率 $\chi_{\mathbf{R}}^{"}$ がローレンツ形の周波数依存性をもつと仮定し、そのピーク値を $\chi_{\mathbf{p}}^{"}$ 、 Γ をその半値幅とした。(2.2.1 2)によりSFR利得 \mathbf{g}_{s} は

$$g_{s} = \frac{16\pi^{2}C^{2}}{\hbar\omega_{s}^{3} \cdot n_{s}^{2}} \left(\frac{d\sigma}{d\varrho}\right)_{t} \frac{I_{o}}{\Gamma}$$
(2.2.13)

と表わされる。 Γ は自発ラマン散乱の線幅として観測され、ラマン利得の広がりを表わす。SFR 散乱では Γ は媒質のキャリア密度、散乱方向と磁場の配置及び磁場強度により大きく変化する $^{(9)(0)(1)}_{\circ}$

InSb に対する波長 10 μ m 領域でのストークス光利得 g_s は 1.7 × 10⁻⁵ cm⁻¹/W・cm⁻² 程度 と報告されている。この値は可視光領域でのCS20もつラマン利得より10³程度大きな値である。 InSb と CS2の自発ラマン散乱の線幅 Γ は同程度であり、散乱断面積 (d σ /d Ω)_t はCS2の方 が大きいから、 InSb の利得が大きい理由は利得 g_s が散乱光周波数 ω_s の3 乗に逆比例するため 赤外域のSFR散乱では可視域の散乱の場合よりも利得が増加するためである。⁽⁹⁾⁽¹²⁾ SFR利得は 後に述べる共鳴効果による散乱断面積の増加を利用して、さらに増大させることが可能で、共鳴条 件下でのラマン利得は、9×10⁻⁴ cm⁻¹/W・cm⁻²程度にも達することが報告されている。⁽¹³⁾

次に、SFR 散乱の散乱断面積について述べる。SFR 散乱の散乱断面積は、散乱に寄与する伝 導電子の分布状態及び電子のSFR 遷移行列要素によって影響をうけるが、ストークス散乱に対して

$$(\frac{\mathrm{d}\,\sigma}{\mathrm{d}\,\varrho})_{\mathrm{t}} = (\frac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{mc}^2})^2 \cdot (\frac{\omega_{\mathrm{s}}}{\omega_{\mathrm{o}}}) \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \sum_{\ell,k_2} |\mathbf{R}|^2 \cdot (1 - \mathbf{f}_{\ell\downarrow} (k_2)) \mathbf{f}_{\ell\uparrow}(k_2)$$

$$(2.2.14)$$

と表わされる。⁽⁴⁾ ここで、 $f_{\ell\downarrow}(k_2), f_{\ell\uparrow}(k_2)$ は量子数 ℓ のランダウ準位に付属した \downarrow スピン準位、 \uparrow スピン準位の電子の占有確率を表わす。また、RはSFR散乱の遷移行列要素、mは電子の 質量、eはその電荷を表わす。SFR散乱の遷移行列要素Rは

$$R = \sum_{t} \left\{ \frac{\langle f | \varepsilon_{s}^{*} \cdot V | t \rangle \langle t | \varepsilon_{0} \cdot V | i \rangle}{\hbar \omega_{0} - (E_{t} - E_{i})} - \frac{\langle f | \varepsilon_{0} \cdot V | i \rangle \langle t | \varepsilon_{s}^{*} \cdot V | i \rangle}{\hbar \omega_{s} + (E_{t} - E_{i})} \right\}$$

$$(2.2.15)$$

と表わされる。ここで | t>はラマン遷移の中間状態を表わし、 | i >、 | t >はラマン遷移の初 期状態と終状態を表わす。また、 ε_s 、 ε_o はストークス光と励起光の偏光ベクトル、Vは速度演算子 である。初期状態と終状態はランダウ準位量子数と磁場方向の波数k々及びスピンの向きによって指 定される。ストークス光の発生過程では電子は伝導帯の │ℓ,kz,↑>準位から中間状態である 価電子帯の状態 ┃ v >に遷移し、次に ┃ v >から伝導帯の ┃ℓ, k 2,↓>準位に遷移すると考えられ る。しかし、この過程では価電子帯の状帯 |v>は空状態でなければならない。n-形半導体は低 温ではこのような条件が満たされないため、むしろ正孔が初期状態 |ℓ, k, ↓> から中間状態 $|v> に励起され、さらに |v> から終状態 | \ell, k_z, 1> に遷移すると考えた方が都合がよい。$ したがって、SFR遷移の生じる確率は価電子帯に電子が存在する確率 $f_v(k_z)$ と $|\ell, k_z, \uparrow>$ 状態に電子が存在する確率 $f_{\ell\uparrow}(k_z)$ とさらに $|\ell, k_z, \downarrow >$ 状態が空である確率 $(1 - f_{\ell\downarrow}(k_z))$ との積に比例することになる。しかし、価電子帯には常に電子が存在するため $f_v(k_z)=1$ と表わ すことができるため(2.2.14)式では、このことが考慮されている。磁場中では kg=0で電子の 状態密度が最大となるため大部分の遷移が kg=0付近で生じると考えられる。従って、遷移行列要 素の kz による変化を無視できる。このことは遷移行列要素に対するエネルギー帯の nonparabol icity による変化を無視することに相当する。この時、遷移行列要素を(2.2.1.4)式の Σ の外に取出し て散乱断面積を

$$(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\varrho})_{t} = (\frac{\mathrm{e}^{2}}{\mathrm{mc}^{2}})^{2} \cdot (\frac{\omega_{1}}{\omega_{0}}) \cdot \mathrm{m}^{2} \cdot |\mathrm{R}|^{2} \cdot \sum_{\ell \mid k_{z}} (1 - f_{\ell \downarrow}(k_{z})) f_{\ell \uparrow}(k_{z})$$
 (2.2.16)

と表わすことができる。また、この仮定のもとでは(2.2.16)式の Σ の前の項を k_z =0で1つの 電子がもつ散乱断面積 | F(0) |²を用いて表わすことが可能となり

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\varrho}\right)_{\mathrm{t}} = |\mathbf{F}(0)|^2 \sum_{\ell, \mathbf{k}_z} \left(1 - f_{\ell\downarrow}\left(\mathbf{k}_z\right)\right) f_{\ell\uparrow}\left(\mathbf{k}_z\right) \qquad (2.2.17)$$

と表わすことができる。

ストークス光の利得 g_s は散乱断面積 $\left(\frac{d\sigma}{dg}\right)_t$ の磁場依存性を通じて磁場と共に変化する。散乱 断面積の磁場依存性を決定する要素は電子の占有確率と遷移行列要素であるが、共鳴効果による遷 移行列要素の増大を考慮する必要のない場合には前者の磁場依存性が支配的である。以下では、は じめに電子占有確率の磁場依存性を考察し、次に遷移行列要素を考察する。

電子の占有確率の磁場による変化は(2.2.17)式の右辺第2項を通じて考察できる。以後、簡 単化のために温度 $\mathbf{T} = 0$ Kを仮定し、電子の占有確率(フェルミ分布関数) $f_{\ell\uparrow,\downarrow}(\mathbf{k}_{z})$ が0ま たは1と表わされる状態を考える。(2.2.17)式の右辺第2項は伝導帯のすべての↑スピン準位

-10-

に存在する電子数N \downarrow とすべての \downarrow スピン準位に存在する電子数N \downarrow の差 (N \downarrow -N \downarrow)を表わす。 磁場を増加すると各スピン準位の電子縮退度が増加するため、電子はエネルギーの低い \uparrow スピン準 位に多く収容されるようになる。このため、 \uparrow スピン準位と \downarrow スピン準位の電子数の差は磁場と共 に増加し、すべての電子が \uparrow スピン準位に収容される時、電子の分布差は最大となり、その後は磁 場が増加しても分布差は一定となる。この電子の分布差の磁場による変化は、全電子数が一定とい う条件からフェルミ準位の磁場による変化を考慮することによって推定できる。以下ではフェルミ 準位の磁場依存性について、まず磁場が強くすべての電子が ℓ = 0 の \uparrow スピン準位に存在する場合 について述べ、その後、磁場の弱い場合を考える。

磁場が強く、すべての伝導電子がランダウ準位量子数 $\ell = 0 \text{ O} \uparrow \varkappa \varkappa$ 準位 (以下(0,1) と表わ すことにする)に存在するとき、すなわちフェルミ準位 E_F が(0, 1)準位と(0, \downarrow)準位の 間に存在するとき、電子の分布差(N $\uparrow - N \downarrow$)は最大となり、SFR散乱に寄与する電子数は最 も多くなる。この状態を図 – 2.2.2(a)に示す。



図-2.2.2 フェルミ準位とランダウ準位の変化

このような状態では、フェルミ単位は磁場の関数として

$$E_{\mathbf{F}}(B) = \frac{1-\nu}{2} \hbar \omega_{c} + \frac{16}{9} \frac{E_{\mathbf{F}}(0)^{3}}{(\hbar \omega_{c})^{2}}$$
(2.2.18)

と表わされる。ここで、 $\omega_{c} = (eB/m^{*}c)$ はサイクロトロン周波数、 $\nu d\nu = (\frac{|g^{*}|}{2}m^{*}/m)$

であり、 $\mathbf{E}_{\mathbf{F}}(\mathbf{0}) = \left(\frac{\hbar^2}{2 \mathbf{m}} * \right) \cdot \left(3 \pi^2 \cdot \mathbf{N}_0 \right)^{\frac{5}{3}}$ は磁場が存在しないときのフェルミ準位を表わ す。このような状態では、電子の分布差は磁場によって変化しないため、利得 \mathbf{g}_{s} の磁場依存性は遷 移行列要素の磁場依存性によって決定される。

次に、このような状態から磁場を弱くしてゆき、フェルミ準位 E_F がランダウ準位量子数 $\ell = 1$ の↑スピン準位と $\ell = 0$ の↓スピン準位の間に存在するようになると((0,↑)< $E_F(B)$ <(1,↓)) 電子の分布差(N↑ - N↓)は減少し、SFR散乱に寄与する電子数も減少する。この状態を図 – 2.2.2(b)に示す。この時、フェルミ準位は磁場の関数として

$$E_{\mathbf{F}}(B) = \frac{1}{2}\hbar\omega_{c} + \frac{4}{9} \frac{(E_{\mathbf{F}}(0))^{3}}{(\hbar\omega_{c})^{2}} + \frac{9}{64} \nu^{2} \frac{(\hbar\omega_{c})^{4}}{(E_{\mathbf{F}}(0))^{3}}$$
(2.2.19)

と表わされる。また、↓スピン準位に存在する電子数は

$$N \downarrow = \left(\frac{2 e B \sqrt{2 m^{*}}}{h^{2} C}\right) \cdot \sqrt{E_{F} - \frac{1 + \nu}{2} \hbar \omega_{c}} \qquad (2.2.20)$$

と表わされ、分布差は全電子数をNとすると

 $N \uparrow - N \downarrow = N - 2 N \downarrow$

と表わされる。この状態ではフェルミ準位は磁場の減少と共に、(1,↑)準位に接近し、電子分 布差はほぼ磁場の3乗に比例して減少する。このため、ストークス光に対する利得g_sも磁場の3 乗に比例して減少するようになる。

また、さらに磁場が減少するとフェルミ準位は順次ランダウ準位量子数の大きい↓スピン↑スピン準位と交差してゆくが、そのたびに分布差は複雑に変化しながら減少するため、利得g_sも磁場の減少と共に減少する。⁽⁶⁾

次に、散乱断面積(2.2.16)式の中の遷移行列要素について考察する。この行列要素を磁場印加のも とでの状態関数を用いて取扱うことは非常に複雑であるので(8) 磁場が存在しないときの状態関数 を用いて近似することにする。しかし、得られる結果はSFR散乱の特性をよく表わす。遷移行列 要素(2.2.15)式の中の|i>, |f> は伝導帯のブロッホ関数とし、|70>と表わす。ここ で0は電子波数k=0を表わすものとする。また、中間状態|t>は、価電子帯にとり|00>と 表わし、エネルギーの高い伝導帯は含めない。この中間状態として作用し得る状態は、|70>とのスピ ン関数の直交性によって軽い正孔帯とスピン軌道分裂したエネルギー帯の二つだけである。

速度演算子Vとしてスピンを考慮した

$$V = \frac{P}{m} + \frac{\hbar}{4 m^2 c^2} (\sigma \times \text{grad } V)$$

を用い、また、 $\omega_0 \simeq \omega_s$ と近似すると遷移行列要素(2.2.15)式は

$$\begin{split} \mathbf{R} &= \sum_{\delta}^{1} \left[\left\{ \frac{\varepsilon_{0}^{*} < \gamma 0 |\mathbf{V}| \delta 0 > < \delta 0 |\mathbf{V}| \gamma 0 > \varepsilon_{s} + \varepsilon_{s}^{*} < \gamma 0 |\mathbf{V}| \delta 0 > < \delta 0 |\mathbf{V}| \gamma 0 > \varepsilon_{0}}{(\varepsilon_{\gamma 0} - \varepsilon_{\delta 0})^{2} - (\hbar \omega_{0})^{2}} \right\} \\ &\times (\varepsilon_{\gamma 0} - \varepsilon_{\delta 0}) \\ &+ \left\{ \frac{\varepsilon_{0}^{*} < \gamma 0 |\mathbf{V}| \delta 0 > < \delta 0 |\mathbf{V}| \gamma 0 > \varepsilon_{s} - \varepsilon_{s}^{*} < \gamma 0 |\mathbf{V}| \delta 0 > < \delta 0 |\mathbf{V}| \gamma 0 > \varepsilon_{0}}{(\varepsilon_{\gamma 0} - \varepsilon_{\delta 0})^{2} - (\hbar \omega_{0})^{2}} \right\} \\ &\times \hbar \omega_{0} \right] \\ &\simeq \left[\left(\frac{\mathbf{E}g^{2}}{\mathbf{E}g^{2} - (\hbar \omega_{0})^{2}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\mathbf{m}^{*}} - \frac{1}{\mathbf{m}} \right) \cdot \left(\varepsilon_{0}^{*} \varepsilon_{s} \right) + \frac{i}{\mathbf{m}} \left(\frac{\mathbf{E}g \cdot \hbar \omega_{0}}{\mathbf{E}g - (\hbar \omega_{0})^{2}} \right) \\ &\times \left(\frac{|\mathbf{g}^{*}|}{2} - 1 \right) \left(\sigma \cdot \left(\varepsilon_{0}^{*} \times \varepsilon_{s} \right) \right) \right] \end{split}$$

$$(2.2.2.1)$$

と表わされる。但し、電子有効質量は

$$(\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}^{*}})_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} + \frac{2}{\mathrm{m}} \sum_{\delta}' \frac{\langle \gamma 0 | \pi_{\mu} | \delta 0 \rangle \langle \delta 0 | \pi_{\nu} | \gamma 0 \rangle}{\varepsilon_{\gamma 0} - \varepsilon_{\delta 0}}$$

$$(\mu, \nu = \mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z} \, \mathrm{E}\mathrm{k}) \quad (2.2.2.2)$$

有効g値は

$$g_{z}^{*} = 2 \left[1 + \frac{2}{im} g_{m} \left(\sum_{\delta} \left(\frac{\langle \gamma 0 \mid \pi_{x} \mid \delta 0 \rangle \langle \delta 0 \mid \pi_{y} \mid \gamma 0 \rangle}{\varepsilon_{\gamma,0} - \varepsilon_{\delta 0}} \right) \right] \quad (2.2.23)$$

また、

$$\pi = P + rac{1}{4mc^2} (\sigma imes \operatorname{gr} \operatorname{ad} V) = mV$$

と表わされることを用いた。⁽⁵⁾ 遷移行列要素(2.2.2.1)式でスピンの反転に寄与する項は第2項 である。この項からSFR散乱の遷移行列要素は、 $| \alpha >$, $| \alpha ' >$ を2つのスピン関数として、

$$|\mathbf{R}^{2}| = \frac{1}{\mathbf{m}^{2}} \left(\frac{\mathbf{E}_{g} \cdot \hbar\omega_{o}}{\mathbf{E}_{g}^{2} - (\hbar\omega_{o})^{2}} \right)^{2} \left(\frac{|\mathbf{g}^{*}|}{2} - 1 \right)^{2} \left(\langle \boldsymbol{\alpha} | \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \times \boldsymbol{\varepsilon}_{s} | \boldsymbol{\alpha}' \rangle \right)^{2}$$

$$(2.2.24)$$

と表わされる。 この遷移行列要素は励起光光子エネルギー $\hbar\omega_o$ が禁制帯幅 E_g に近づくと共鳴的に増大する項を含む。このため $\hbar\omega_o\simeq E_g$ では散乱断面積の増加によってSFR利得 g_s は増加する。

(共鳴効果)。n-InSb ではこの条件は励起光としてCOレーザー(発振波長~5μm)を用いた場合に実現され、この条件下でのSFR散乱を共鳴SFR散乱とよぶ。⁽¹³⁾ また(2.2.24)式第2項

$$W = \left\{ \frac{\hbar\omega_{o} \cdot E_{g}}{E_{g}^{2} - (\hbar\omega_{o})^{2}} \right\}^{2}$$
 (2.2.2.5)

を特に共鳴係数とよび、共鳴効果の大きさを見積る目安として用いる。

(2.2.2.4)式からSFR散乱の遷移行列要素は伝導電子の有効g値と共に増加することがわかる。 InSb の伝導帯端はS軌道類似であり、価電子帯はP軌道類似で価電子帯端に存在するP $\frac{3}{2}$ の準位とスピン軌道相互作用によって価電子帯端から $d \simeq 0.9 \text{ eV} 分裂したP\frac{1}{2}$ の準位から成立っているため、(2.2.2.3)式で表わされる伝導電子有効g値は

$$g^* \simeq 2 - \frac{m}{m^*} \left(\frac{2 \Delta}{3E_g + 2 \Delta} \right)$$
 (2.2.26)

となり、その値も-50程度となる。このように大きなg値は、禁制帯幅が小さいことと、スピン 軌道相互作用による $P_{\frac{1}{2}}$ 準位の分裂大きいことにより生じている。⁽⁶⁾ また、スピン軌道相互作用に よる価電子帯の分裂が存在しないときには $\Delta = 0$ であり、有効g値は2となる。この時、遷移行列 要素(2.2.24)式は零となる。このことはSFR散乱がラマン媒質のスピン軌道相互作用にもと づく効果であることを示している。

ここでは磁場が存在しない場合の遷移行列要素を考察したが、この考え方を拡張して、磁場中での遷移行列要素を定性的に論じる事ができる。磁場の存在は(2.2.1)式の $\hbar\omega_c/2$ の項の寄与を通じて禁制帯幅を増加させる。その結果遷移行列要素(2.2.2.4)式は第2項と有効g値の減少により、磁場の増加と共に減少することになる。Dennisらはエネルギー帯のnonparabolicity及び磁場中でのランダウ準位の変化を考慮した遷移行列要素の詳細な計算を行ない、高磁場(100kG以上)ではランダウ準位量子数 $\ell=1$ の準位も中間状態として作用し得る事を指摘している。⁽⁸⁾

§2.3 実験装置及び実験方法

本実験で使用し た装置のブロック 図を図-2.3.1 (a) に示す。ラマン共 振器として用いた n-InSb 単結晶 は電子密度 2.3× 10^{16}cm^{-3} (77K) で、その形状は図 -2.3.1(b)に示して いる。 SFR 共振 器の仕上り平行度 は12秒程度共振 器表面の平相度は $\lambda/5$ (λ th NaOD 線)程度である。 との共振器は光学

測定用超電導マグ



- 2.3.1 InSb SF R レーサー美験装置(a) ラマン共振器(b)

ネット(最大磁場50kG)のコールドフィンガーに取付け、実験中は温度10Kに冷却した。励 起光源として使用したTECO₂レーザーの発振波長は共振器の1端面を構成する回析格子により単一波 長を選択することが可能である。このCO₂レーザーのピーク出力は約400kW(10.59 μ m)で、バルス繰返しば約 3 p.p.sである。また、NaCl製のブリュスター窓を取付けることによって、直線偏光した出力光が得られ る。CO₂レーザー出力はSi製ビームスプリッターによりその一部を取出し、ラマン共振器に入射す る光強度をモニターした。散乱光は、励起光光軸と同一光軸上で取出した。これら二つの光軸は共 に磁場に垂直である。励起光は焦点距離15 cmのKRS-5 製のレンズを用いて集光し、BaF₂製 のマグネット窓を通してラマン共振器端面上に照射した。一方、散乱光はマグネット窓を通して取 出し、焦点距離46 cmのBaF₂製レンズを用いて分光器に導入し、励起光の共振器透過光を除去し た後、光検出器に導入した。SFR散乱光の検出は小型冷凍機によって、温度30Kに冷却したHg ドーブGeの光導電セルによって行なった。この検出器の10.59 μ m光バルスに対する検出限界は 10 μ W/cm²程度である。光検出器を出たSFR信号は2現象シンクロスコープで励起光と同時にモ ニターを行ない、ボックスカー積分器で平均化した後、レコーダーに記録した。

§ 2.4 SFRレーザー出力の励起強度依存性

SFRレーザー出力は励起光強度が発振しきい値を超すと急激に増加する。図 - 2.4.1 は励起光 偏向方向を磁場と垂直(E₀→B)としたときの磁場 45 kGにおけるSFR光出力の励起光強度依存

性である。励起光波長は10.59 µmであり、 試料上で励起 光ビーム直径が約200 µmとなるように集光を行なった。 図-2.4.1からわかるように、SFR出力は励起光入力が 約4.2 kW (励起強度約0.5 MW · cm⁻²)以上になると急激に 増加する。また、出力増加後のSFR光の指向性は極めて 鋭く、出力光の広がり角は約5.7分である。このような 励起強度に対する出力の急激な増加と、鋭い指向性は出 力光がレーザー発振を行なっていることを示している。レ ーザー発振のしきい値は後に§2.5.2で述べるように共 振器長等の実験条件により異なるため、一概に比較すると とはできないが、ここで得た値はAggalwal らが報告し た値 $0.4 \,\mathrm{MW} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$ とほぼ一致している⁽²⁾ また、励起 光強度2MW・cm⁻²付近で生ずる出力の飽和はこれまで励 起領域中のストークス光発生に寄与する電子が欠乏するた め生ずると考えられてきたが、むしろこの現象は後に4章 で示すように強い励起光によって共振器内部に正孔が生成 され、この正孔によって励起光及びストークス光が強く吸 収されるため共振器内の損失が増加して生じると考えられ



励起強度依存性

る。このように出力が飽和することから励起強度を増大させるだけではSFRレーザー出力を増大で きないことがわかる。実際、この実験では励起光の集光直径を約4mm程度(励起強度約08MW・cm⁻²) と大きくし、共振器の励起体積を増加した時に、最大のSFR出力約1.2kWが得られた。(図-2.5.3)

§ 2.5 SFR レーザー出力の磁場依存性

2.5.1 同調特性

SFRレーザー出力の同調特性を図 – 2.5.1 に示す。SFRレーザーの発振周波数 ω_1 は磁場により変化し、励起光周波数を ω_0 とすると

$$\omega_1 = \omega_0 \pm |g^*| \cdot \mu_B \cdot B/\hbar \qquad (2.5.1)$$

である。この実験では励起光波長を10.59 μ m とし、励起光偏光方向を磁場と平行とした時、スト ークス光は磁場29kGから50kGの範囲で観測可能で、その波長は11.38 μ mから11.75 μ m ま で変化した。一方、反ストークス光は、磁場30kGから50kGの範囲で9.94 μ mから9.6 μ m まで 変化した。(2.5.1)式からわかるようにSFRレーザーの発振波長は単に磁場を変化させるばか りでなく励起光周波数を変化することによっても粗く変化できる。図 – 2.5.1には励起光として、 10.53 μ mと10.67 μ m光を用いた場合のストークス光出力の変化を同時に示しているが、これらの 励起光を用いるとストークス光の波長可変範 囲は11.26 µmから11.90 µmまで拡大できる ことがわかる。しかしながら、励起光波長を 10.33 µm より短波長とした場合には、励起 密度を発振しきい値を十分超えると考えられ る 0.8 MW·cm⁻² 程度としてもストークス光出 力を観測できなかった。短波長の励起光に対 してストークス光の発振が抑制される原因に ついてはストークス光の利得そのものが急激 に減少するとは考えられないため、共振器内 部の光損失が増加することによると考えられ る。このような励起光波長に依存する損失と しては、後に4章で述べるように、励起光波 長が短くなると共に2光子吸収が発生し、価 電子帯に正孔が作られるようになるため、正 孔の価電子帯間の遷移が可能となり励起光及 びストークス光の正孔による吸収損失が増加する



図-2.5.1 SFRレーザー出力の同調特性

ことが考えられる。また、この損失機構は励起強度と共に増加するため、 図 – 2.4.1 でも示したように 励起波長 10.59 μ m でも 2MW・cm⁻² 以上と高い励起強度では SFR 出力の飽和を引きおこす原因と なると考えられる。

この実験から得られたストークス光 の単位磁場当りの周波数シフトは約2 cm⁻²・kG⁻¹であるが、この値は伝導電子 有効g値が磁場と共に減少するため磁 場の増加と共に減少する。この実験か ら得られた伝導電子有効g-値の磁場 依存性を図-2.5.2に示す。磁場の増 加と共に伝導電子の有効g値が減少 する原因は、磁場の増加と共に禁制 帯幅が増加するため、伝導帯と価電子 帯との相互作用が弱められることによ ると考えられる。すなわち(2223)式 で表わされる有効g-値の分母が磁場 と共に増大することによると考えられ る。



励起光(1059µm)の偏光ベクトルEoを磁場と平行(Eo//B)とした時のストークス光出力の

磁場による変化を図 - 2.5.3 に示す。図中に示 した実線は実験値を、破線は次節で述べる方法に よる計算値を示している。ストークス光出力は 磁場約28 kGから観測され始め、磁場の増加 と共にいくつかの極小値をもちながら増大し、 磁場約45 kGで最大となった後、急激に減少 する。磁場45 kGで、励起光強度0.8 MW・ $cm^{-2}($ 集光直径約4 mm)におけるストークス光 出力のピーク値は約1.2 kWに達した。この最大 出力が得られる励起条件での励起光からストー クス光に変換される光パワーの変換効率は約 1.2%である。この変換効率はPatelの報告し た値約1%とほぼ一致している。⁽⁹⁾

励起光偏光ベクトル E_o を磁場と垂直 $(E_o \perp B)$ とし、同様な励起密度及び集光条件で観測した ストークス光強度の磁場による変化を図 – 2.5. 4 に示す。図中の実線および破線はそれぞれ実 験値および理論値を示している。この配置の場 合、ストークス光出力は磁場33kG 付近から観測 され始め、磁場45kG でピークとなり、その後 減少した。

 $E_0 / B 配置 & E_0 \perp B 配置で得られた結果を$ 比較すると、後者では出力を確認できる最低磁場が5 kG程度高磁場側にシフトし、また、最大出力も前者の10%程度に減少することがわかる。このような励起光偏光方向による出力の $変化は、<math>E_0 \perp B$ 配置に対して共振器内部の光吸 収損失が特に増加するとは考えられないため、 $E_0 \perp B 配置の場合に、 E_0 / B よりもストークス$ 光利得そのものが小さくなることが原因と考え



られる。Yafetはこの実験で用いたのと同様な配置に対する遷移行列要素の大きさを計算し、 $E_0 \perp B$ 配置では E_0 / B 配置よりも遷移行列要素が小さくなることを示している。 $^{(19)}$ このことは、 $E_0 \perp B$ 配

置に対する出力の減少と対応している。

図-2.5.3と図-2.5.4に示したストークス光出力でみられるいくつかの極小は、これらが生じ

る磁場付近で、ストークス周波数 $\omega_s 及$ ¹⁵⁰⁰ び励起光周波数 ω_c が、高次のサイクロ トロン周波数 $n\omega_c$ (n:整数)⁽²⁾及び これに縦光学フォノン周波数が加わった 周波数 ($n\omega_c + \omega_{L0}$) に一致するた め(図 - 2.5.5)、ストークス出力及び 励起光が共振器内部で高次のサイクロト ロン共鳴により共鳴吸収されて生じたと 考えられる。図 - 2.5.3と図 - 2.5.4 に はこれら周波数が一致する磁場を矢印で 示し、同時にその周波数を記している。 これまで、本実験と同様な周波数で高 次のサイクロトロン吸収を測定した例は



少ないため、遠赤外光を用いた測定結果⁽²⁾⁽²⁾をもとに、ここで得た結果を検討する。その結果によると 共鳴吸収は磁場と垂直な方向(E \perp B)の光に対して顕著となると報告されている。ここで行った 実験では、出力光中に含まれた磁場と垂直な方向の偏光成分と、それ以外の偏光成分を識別して測 定していないが、既に報告されている自発ラマン散乱の測定結果⁽²⁾から推定すると、ここで用いた 励起条件すなわちE₀//B及びE₀ \perp Bに対して、ラマン利得は磁場と平行及び垂直(E_s//B, E_s \perp B)に偏光した成分のみが特に大きく、レーザー発振を生じ得ると考えられる。従って、ス トークス光出力の極小が生じる磁場では、E_s \perp Bの出力光のみが吸収をうけるため、出力光中の 二つの偏光成分すなわちE_s//BとE_s \perp Bの強度比がそれ以外の磁場と異なる可能性がある。図 -2.5.3 で6 ω_c (CO₂)と記した出力の極小値は励起光周波数が6倍のサイクロトロン周波数と 一致するため、共鳴吸収されて生じたと考えられるが、それ以外の周波数及び励起光偏光方向で検 出できなかった理由は明らかではない。

励起光及びストークス光出力がサイクロトロン共鳴吸収をうけるためには、

 $\omega_s = \delta \omega_t \omega_0 \simeq n \omega_c = \delta \omega_t n \omega_c + \omega_{10}$ (2.5.3)

の条件が成立することが必要である。この条件は励起光の周波数ω₀を固定すると、特定の磁場に おいて満される。図 - 2.5.7 に示すように、10.53 μm光ではストークス光と高次のサイクロト ロン周波数及び縦光学フォノンが加わった周波数が一致する磁場が高磁場側にシフトする。従って 周波数の異なる励起光に対しては共鳴吸収の発生する磁場が変ることになる。励起光として10.67 μm及び10.53 μm光を用いた場合の出力強度の磁場による変化を図 - 2.5.6 に示す。この結果



で表わされる。ここで、量子数 ℓ のランダウ準位に付属する磁場と平行なスピン (ℓ , \uparrow)状態の 電子存在確率を f $_{\ell}$ \uparrow で、反平行なスピン (ℓ , \downarrow)状態の電子存在確率を f $_{\ell}$ \downarrow で表わした。また、磁場方向の波数 k₂=0 での1 電子当りの散乱断面積を | F(0) |²で表わした。(2.5.5) 式に示 したように散乱断面積は (ℓ , \downarrow) 状態の空状態数と (ℓ , \uparrow) 状態の電子数に比例する。従って $7 \pm n \ge 4$ 位の磁場依存性から散乱断面積の磁場依存性を評価できる。

本実験で用いた InSb 共振器 (電子密度 n_e = 2.3×10¹⁶ cm⁻³) について、フェルミ準位の 磁場による変化を (2.2.18) 式及び (2.2.19) 式によって計算し、図 - 2.5.8 に示す結果を得

た。但し、電子有効質量は、電子密度10¹⁶cm⁻³程度 のn-InSbについて報告された値m*= 0.0156m⁽²⁾, 電子有効g値は図 - 2.5.2 で示したこの実験で得た 値を使用し、温度はT=0Kを仮定したが、実験温 度10Kでも電子の分布はほとんど変化がないと考え られる。図-2.5.8から磁場が20kGから45kG の範囲ではフェルミ準位は(1, ↑)状態と(0, ↓)状態の間にあり、磁場の増大と共に(0,↓) 状態に接近するため(0, ↑)状態と(0, ↓)状 態の電子の分布差は大きくなり散乱断面積は増大す る。また、磁場が45kGを超えるとフェルミ準位 は(0,↓)状態と(0,↑)状態の間に入るため (0, ↑)状態と(0, ↓)状態の電子差は最大と なり、変化はなくなる。この磁場以上では、散乱断 面積で電子分布差に依存する項は変化しなくなるが 1電子当りの散乱断面積 | F(0) |² が遷移行列要素 の減少によって磁場と共に減少するため、散乱断面 積 $(d\sigma/d\Omega)_{t}$ は磁場と共にゆるやかに減少する。





図 - 2.5.9 に(2.5.4)式と(2.5.5)式から 計算したストークス光利得 g_s の磁場による変 化を示している。但し、この計算では正味の励 起光密度 I_o は共振器端面での反射損失を考慮 し、510kW・cm⁻² とした。また、ストークス光 周波数での共振器屈折率として Π_s ~3.9、自発ス トークス線幅 Γ ~2 cm⁻¹⁽⁹⁾を用いた。また、 散乱断面積に含まれた遷移行列要素はDennis⁽⁸⁾ の計算結果を使用した。なお、図 - 2.5.9 に示 した利得 g_s には、図 - 2.5.3 に点線で示した 励起光周波数が6倍のサイクロトロン周波数と 一致した時に生じる励起光共鳴吸収による利得 の減少を考慮している。

一方、ストークス光の損失としては、次の3種類の損失機構が考えられる。

- 1) 共振器端面での反射損失
- 2) 共振器内の伝導電子による光吸収損失、 α_f
- 3) 高次のサイクロトロン周波数及び、これに縦光学フォノンが加わった周波数で発生する共鳴吸 収損失、*Q*

1)と2)の機構はこの実験で使用した磁場範囲では、磁場に関して大きく変化しないが、3)のサイク ロトロン共鳴に関係した損失は、図 - 2.5.5 で示した特定の磁場のみで発生する。高次のサイクロ トロン共鳴吸収の吸収係数に関して、これまであまり詳細な実験及び計算は行なわれていないが、 赤外サイクロトロン共鳴の実験結果⁽³⁾⁽²⁾⁽²⁾の外挿からおよその値を推定できる。図 - 2.5.9 には上 記3種の損失機構を考慮した損失係数 $\alpha_f + \alpha_c - \ln R / \ell c$ 示している。ここでRは共振器端 面での反射率でR \simeq 0.3 6 である。また、 ℓ は共振器長で、 $\ell = 0.5$ cmとした。

ストークス光利得 g_s と損失 $\alpha_f + \alpha_c - \ln R / \ell$ からストークス光出力を計算することができる。SFRレーザーが発振するためには

$$\operatorname{Rexp}\left\{ \ell \left(g_{s} - \alpha_{f} - \alpha_{c} \right) \right\} > 1$$

$$(2.5.6)$$

の条件が満足されることが必要である。この条件は

$$g_{c} > \alpha_{f} + \alpha_{c} - \ln R \neq \ell$$
(2.5.7)

と変形できるが、左辺のストークス光利得 g_s および右辺の損失係数 $\alpha_f + \alpha_c - \ln R / \ell$ の磁場による変化をそれぞれ独立に図 – 2.5.9 に示している。ストークス光利得の損失に対する割合を

$$p = g_{s} / (\alpha_{f} + \alpha_{c} - \ln R / \ell)$$
(2.5.8)

で定義すると、パルス励起中に生じる電子のスピン準位間の緩和を無視し、励起光強度の空間分布 をガウス分布で近似できる時にはストークス光出力は

$$J = n_e \hbar \omega_s \pi \gamma^2 \ell (\ln p + \frac{1}{p} - 1)$$
 (2.5.9)

で与えられる。⁽⁴⁾⁽²⁾ ここで n_e は共振器内の電子密度、 γ は励起光ビーム半径で $\gamma = 0.2$ cmである。 図 - 2.5.9 に示したストークス光利得 g_s と損失係数を用い(2.5.9)式によって計算した出力J を図 - 2.5.3 に示している。この図からわかるように励起光偏光ベクトルを磁場と平行(E_o/B) とした時、計算結果は実験値とよく一致する。一方、励起光偏光ベクトルと磁場が垂直な配置 ($E_o \perp B$) に対する計算結果を図 - 2.5.4 に破線で示している。この場合には、遷移行列要素と して Yafet の⁽¹⁹⁾計算結果を用いた以外は(E_o/B)の場合と同様な計算を行なった。 $E_o \perp$ B配置 では計算値と実験値との定量的な一致はよくないが、計算値は実験値のおおよその傾向を反映する ことがわかる。

§ 2.6 結 言

TECO2 レーザー励起n-InSb スピン・フリップ ラマンレーザーの製作と、基礎発振特性の測定 を行ない以下の結論を得た。

- SFR レーザーは、30 kGから50 kGの磁場範囲で発振する。その磁場範囲においてストー クス光については11.26 μmから11.90 μmまで、また、反ストークス光については9.94 μmから9.60 μmまでの範囲で発振波長を同調することが可能である。
- 2) ストークス光がレーザー発振を生じるしきい値の励起強度は $0.5 \text{ MW} \cdot \text{cm}^{-2}$ である。また励起 光強度が $2 \text{ MW} \cdot \text{cm}^{-2}$ を超えるようになると、ストークス光出力は飽和するようになる。
- 3) ストークス光光刀の最大値は磁場45kGの時得られ1.2kWであった。この時、励起光からストー クス光への変換効率は約1.2%となった。
- 4) ストークス光出力は、磁場の増加と共にいくつかの極値を伴いながら増加し、磁場45kGで最 大に達した後、減少する。磁場の増加に伴う出力の増大は、ラマン遷移の始状態と終状態の電 子分布差が大きくなることを通じて利得が増大する結果生じる。また、出力の極小値及び高磁 場での減少は高次のサイクロトロン共鳴吸収が発生することにより、共振器内部の光吸収損失 が増大するため生じる。
- 5) ストークス光利得と共振器内光吸収損失の磁場依存性を考慮して、ストークス光出力を計算した結果、発振磁場範囲で実験との間によい一致が得られた。

参考文献

- 1) C.K.N.Patel and E.D.Shaw; Phys. Rev. Letters <u>24</u> (1977) 451.
- R.L.Aggalwal, B.Lax, C.E.Chase, C.R.Pidgeon and D.Limbert; Appl. Phys. Letters <u>18</u> (1971) 383.
- K.Yasuda, H.Kondo, J.Shirafuji and Y.Inuishi; Jpn. J. Appl. Phys. <u>16</u> (1977) 1075.
- K.Boyer; 'Laser Photochemistry, Tunable Laser and Other Topics' (ed. S.F.Jacobs et al., Addison-Wesley, London, 1976) p. 1.
- 5) C.Kitell; 固体の量子論、丸善(1972) 堂山訳
- 6) E.O.Kane; J. Chem. Solids <u>1</u> (1957) 249.
- R.H.Pantel and H.E.Puthoff; 'Fundamentals of Quantum Electronics' (John Wiley & sons, New York, 1969) 234.
- R.B.Dennis, C.R.Pidgeon, S.D.Smith, B.S.Wherrett and R.A.Wood; Proc. R. Soc. London <u>A331</u> (1972) 203.
- 9) C.K.N.Patel and E.D.Shaw; Phys. Rev. <u>3</u> (1971) 1279.
- S.R.J.Brueck and F.A.Blum; Phys. Rev. Letters <u>28</u> (1972) 1458.
- S.R.J.Brueck and A.Mooradian; Opt. Commun. <u>8</u> (1973)
 263.
- 12) E.P.Ippen; Appl. Phys. Letters <u>16</u> (1970) 303, J.G.Skinner and W.G.Nilsen; J. Opt. Soc. Am. <u>58</u> (1968) 113.
- A.Mooradian, S.R.J.Brueck and F.A.Blum; Appl. Phys. Letters <u>17</u> (1970) 481.
- B.S.Wherrett and P.G.Harper; Phys. Rev. <u>183</u> (1969)
 692.
- S.R.J.Brueck, A.Hooradian and F.A.Blum; Phys. Rev. <u>7</u> (1973) 5253.

- 16) E.S.Wherrett, S.Wolland, C.R.Pidgeon, R.B.Dennis and S.D.Smith; Proc. 12th Intern. Conf. Phys. Semicond., Stuttgart, 1974 (ed. B.G.Teubner, Stuttgart, 1974)
 p. 793.
- 17) P.A.Wolff; 'Nonlinear Optics' (ed. P.G.Harper and B.S.Wherrett, Academic Press, London, 1977) p. 175.
- L.M.Roth, B.Lax and S.Zwerdling; Phys. Rev. <u>144</u> (1959)
 90.
- 19) Y.Yafet; Phys. Rev. 152 (1966) 858.
- 20) E.J.Jhonson and D.H.Dickey; Phys. Rev. <u>B1</u> (1970) 2676.
- 21) R.C.Enck, A.S.Saleh and H.Y.Fan; Phys. Rev. 182 (1969) 790.
- 22) C.K.N.Patel and K.H.Yang; Appl. Phys. Letters <u>18</u> (1971) 491.
- R.B.Dennis, W.J.Firth, A.Mcneith, C.R.Pidgeon, S.D.Smith,
 B.S.Wherrett and R.A.Wood; Proc. Intern. Conf. Phys.
 Semicond., Warsaw, 1972 (Scientific Publishers,
 Warsaw, 1972) p. 364.
- 24) R.G.Mellish, R.B.Dennis and R.L.Allwood; Opt. Commun. <u>4</u> (1971) 249.
- 25) R.B.Dennis, R.A.Wood, C.R.Pidgeon, S.D.Smith and J.W.Smith; J. Phys. <u>C5</u> (1972) L73.

第3章 n–Pb _{0.88} Sn _{0.12} Te SFR レーザー

§3.1 緒 言

波長10µm領域で動作するInSbSFRレーザーはバルス発振として実現されているが、こ の波長領域で連続発振可能なSFRレーザーを構成するためには励起CO2レーザー光に対して共鳴 効果を期待できる材料を共振器として使用することが不可欠である。共鳴SFR効果は励起光光子 エネルギーをラマン媒質とする半導体結晶の禁制帯幅に近づけると価電子帯上端部が伝導電子のラ マン遷移の中間状態として有効に作用するようになるために生じ、この状態のもとではラマン遷移 の発生する確率が増大する。また、共鳴効果が表われるようになるとラマン遷移確率の増大を通じ て、ラマン利得も増大するようになる。共鳴ラマン効果を利用するとSFRレーザーの発振に必要 な励起しきい値強度の低減が可能となるため、連続発振のレーザーを励起光源とした連続発振SFR レーザーを実現できる。

波長10 μ m領域の有力な光源であるCO₂ レーザー光に対して共鳴ラマン効果を期待できる材料 としてはHgCdTe及びPbSnTe混晶がある。これらの混晶はHgとCd及びPbとSnの 組成比を変化することにより禁制帯幅を変化できるため⁽¹⁾ 共鳴効果を活用できる波長範囲を10 μ m 領域からさらに広範囲に拡張できる可能性がある。また、これらの混晶は伝導電子の有効g値 が大きいためSFRレーザー出力光の単位磁場当りの周波数シフトも大きくなる利点がある。 n-Hg_{1-x}Cd_xTe(x=0.23)混晶を用いたSFRレーザーはSlatterら⁽²⁾により報告され、

連続発振も実現されているが、 $n - Pb_{1-x}Sn_xTe(x=0.12)$ については著者らが⁽³⁾ バルス動作ではあるが発振に成功し連続発振の基礎となる共鳴効果の存在を確認した。

本章では、TECO₂レーザーを励起光源としたn-PbSnTeSFRレーザーの基礎発振特性について述べる。3.2節では共鳴ラマン散乱を概説し、3.3節で共振器作成法及び実験方法を述べた後 3.4節以下で本実験から得られたn-PbSnTeSFRレーザーの基礎発振特性として、ストークス光 出力の励起光強度依存性、励起光周波数依存性及び磁場依存性について述べる。

§ 3.2 共鳴SFR散乱の原理

すでに2章で述べたように、SFR散乱では励起光の光子エネルギーが共振器結晶の禁制帯幅に 近づくに、価電子帯上端部がラマン遷移の中間状態として有効に作用し、ラマン遷移の生じる確率 が増大する。SFR散乱の遷移行列要素は(2.2.2.4)式で示したように

$$|\mathbf{R}^{2}| = \left[\frac{1}{m} \left(\frac{\hbar\omega_{0} \cdot \mathbf{E}_{g}}{\mathbf{E}_{g}^{2} - (\hbar\omega_{0})^{2}}\right) \left(\frac{|\mathbf{g}^{*}|}{2} - 1\right)\right]^{2}$$
(3.2.1)

と表わされる。励起光の光子エネルギーが禁制帯幅に近づくと発散する項をWで表わすと

$$W = \left(\frac{\hbar\omega_{o} \cdot E_{g}}{E_{g}^{2} - (\hbar\omega_{o})^{2}}\right)^{2} \qquad (3.2.2)$$

となるが、これを共鳴係数と呼ぶことにする。この共鳴係数は励起光波長及び禁制帯幅に依存し、 磁場と共に変化する。共鳴ラマン散乱ではこの共鳴係数の変化を考慮するため(2.2.16)及び (2.2.17)式で表わしたSFR散乱断面積を改めて

$$(d\sigma/d\Omega)_{t} = |F'(0)|^{2} \cdot W \cdot \sum_{\ell,kz} (1 - f_{\ell\downarrow}(k_{z})) f_{\ell\uparrow}(k_{z})$$
 (3.2.3)

と表わすことにする。ここで | F'(0) |²は (2.2.17) で表わした $k_z=0$ での1電子散乱断面積から共鳴係数を除いた残りの因子を表わす。また、 Σ の中はSFR散乱に寄与する有効電子数であり2章2節で述べたように磁場と共に大きく変化する。従って、共鳴効果が存在する状態ではSFR利得 g_s (2.2.13)式は共鳴係数Wの磁場及び励起光波長依存性とラマン遷移に寄与できる有効電子数の磁場依存性によって決定される。

§3.3 実験装置及び実験方法

3.3.1 SFR共振器

SFR共振器として使用した n-Pb_{0.88}Sn_{0.12}Te単結晶は電子密度 n_e=10ⁿcm⁻³ (77K) 寸法は 5×4×3 m³である。5×4 m³の2 面を 0.3 μ m のアルミナ研磨材で鏡面研磨し、平行度 約12分に仕上げた。PbSnTe結晶は非常に柔らかいため、平行平面に研磨するのが困難で ある。そこで研磨用のヤトイとして結晶と同じ厚みをもつアルミ製円板を使用し、結晶を円板中 央部の穴にはめこんで研磨を行った。研磨中は数回He-Neレーザーを用いて端面の平行 度を測定し、修正を加えながら平行度を高めた。研磨終了後、沸騰したアセトン中で洗浄した。 洗浄後は、直ちに超伝導マグネットのゴールドフィンガーに取付け実験終了時まで真空中(10⁻⁵ ~10⁻⁶mmHg)に保存した。研磨終了後1年程度乾操空気中に保存した共振器ではSFR散乱光は 観測できなかった。これは共振器表面に酸化膜が形成されるか、あるいはガス吸着を生じ、こ れらが励起光や散乱光を吸収するためではないかと推定される。

3.3.2 実験条件

 $Pb_{1-x}Sn_x$ Teは Pb と Sn の組成比及び温度に依存して禁制帯幅が大きく変化することが知られている。⁽¹⁾ この結晶の禁制帯幅は磁場が存在しないとき

 $E_g(x, T) = 0.187 + 4.85 \times 10^{-4} T - 0.543 x + 0.02 x^2$ (eV) (3.3.1)

と表わされる。⁽⁷⁾ ここで、xはSn組成、Tは絶対温度である。この式から実験温度10K での禁制帯幅は122meVと計算できる。磁場は結晶の<100>軸方向に印加し、 散乱光は図-3.3.1 に示 したように励起光光軸方向と 同一方向(collinear)に 取出した。散乱光および励起 光の光軸は共に磁場と垂直で ある。この実験で使用した装 置は第2章で述べた装置と大 部分が同一であるので、詳細 な説明を省略し異なる点のみ を述べることにする。励起CO₂ レーザーは重水素サイラトロ ンにより放電の制御を行ない



パルスごとの出力の変動及び雑音を減少させた。また、散乱光を分光器に導入する際、アルミ蒸着の 球面反射鏡(f=55cm)を使用し、散乱光の波長変化に伴う集光条件の変化を防止した。

§3.4 SFRレーザー出力の励起強度依存性

磁場16kGで励起光(10.54µm)強度を変化させた時のストークス光出力の変化を図-3.

4.1 に示す。ストークス光出力は励起光強度 0.6 MW・cm⁻² から観測され始め、励起光強度の増加と共に出力は急激に増 加する。この時、出力光の広がり角は7分程度であった。こ のような出力の励起光強度の増加に伴う急激な変化と高い指 向性は出力光がレーザーとなっている事を示している。また、共振器 平行度が18分程度の場合にはストークス光出力を観測できなか ったが、これは共振器Qの低下によると考えられる。ストー クス光出力の最大値は磁場16kGで励起光強度7MW・cm⁻² の時得られ、約6.6 m Wであった。この最大出力時における 入射光からストークス光へのパワー変換効率は 3×10 ^{−6}% で ある。このように変換効率が低い原因としては共振器平行度 が12分程度と低いこと及び共振器内の電子密度が10¹²m⁻³ と高いため励起光やストークス光の伝導電子による吸収損失 が大きいことが考えられる。しかしながら、InSb共振器では 共振器平行度が12分程度と低い場合にはレーザー発振を観 測できなかったことから推察するとn-PbSnTeのラマ



ン利得は2章で述べたn-InSbの利得よりも共鳴効果によって大きくなっていると

考えられるが、これについては 3.5 節で再び 述べる。

磁場16kGでのストークス光出力のスペクト ルを図-3.4.2に示す。この図に示したスペクト ル幅は測定系の分解能R(~1cm⁻¹)によって制限 されており、実際のスペクトル幅はこれよりさら に狭いと考えられる。

§ 3.5 SFRレーザー出力の磁場依存性

3.5.1 同調特性

ストークス波長の磁場による変化を図ー 3.5.1 に示す。図中には第2章で述べたn-InSb 共振器に対するストークス光波長の変 化を比較のために示している。ストークス光出 力は磁場8kGから41kGの範囲で観測され、 その波長は10.82µmから11.78µm まで変化 する。ストークス光の同調率は磁場の 増加と共に除々に減少するが、これは 第2章で述べたように伝導電子の有効 g値が磁場の増加と共に減少するため 生じる。ストークス光の磁場20kG における同調率は 2.65cm⁻¹・kG⁻¹ で ある。この値は n-InSb 共振器で の同調率 2cm⁻¹・kG⁻¹より大きい。こ のように同調率が大きい理由は n-Pb0.88Sn0.12Te の伝導電子有 効g値が60~50とInSbより大き いことによる。励起光周波数 ω_{0} とス トークス光周波数のから共振器として 使用した n-Pb 0.88 S 0.12 Te の伝導 電子有効g値を次式によって計算し た結果を図-3.5.2に示す。

$$|\mathbf{g}^*| = \frac{\hbar}{\mu_{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{B}} (\omega_0 - \omega_1)$$









本実験では磁場を<100>軸方向に印加し たがPbSnTeの有効g値はSnの組成比及 び磁場と<111>軸とのなす角度によって変化 することが知られている。PbSnTeの伝導 帯は多谷構造で、ブリリュアン帯のL点と等価 を位置に4つの極小値を持ち、等エネルギー面は <111>軸と等価な方向に長軸をもつ回転随 円体となっている。(9)(10) このため<111>軸 方向に磁場を印加した時には(B/<111>) 等エネルギー面の<111>軸に垂直な面上をサ イクロトロン運動をする電子が表われる。この状 態にある伝導電子のサイクロトロン質量は最も小 さくなり(1) 単位磁場当りのサイクロトロン周波数 は最も大きくなる。従って、この状態での電子の全 磁気モーメントは最大となり、(2.2.23)式で示し た関係により伝導電子の有効g値は最大となる

ことがわかる。また、以上述べたことから、逆に<111>軸と垂直方向に磁場を印加した時 (B \perp < 111>)、最も小さなg値が表われることがわかる。また、L点と等価な位置に 4つの伝導帯谷があるため<111>軸に平行あるいは垂直な方向に磁場を印加した時には2 つのg値が観測される。⁽²⁾一方、本実験のように<100>軸方向に磁場を印加した場合には4つ の等エネルギー面上をサイクロトロン運動する電子の軌道がすべて等価となるため観測されるg値 はただ1つとなる。以上述べたことから、ストークス光同調率は磁場方向を<111>軸方向、 (B // <111>)とした時にはさらに増大できると考えられる。Greev⁽⁵⁾の報告した電子有効 g値の結晶軸依存性をもとに、本実験で用いた結晶をB // <111>として用いた時に期待できる有 効g値を計算すると90程度となり、ストークス光の同調率は4.2 cm⁻¹ kG⁻¹になると考えられる。

図-3.5.2 に示した結果から有効g値は磁場 10kGから41kGの範囲で59から51まで 変化することがわかる。このように磁場の増加と共に有効g値が減少する原因は2章でInSbにつ いて述べたと同じ機構によると考えられる。また、実験で得た有効g値の値を零磁場まで外挿する と61.7 となる。この値はこれまで報告されている磁場中での再結合発光⁽⁴⁾⁽⁵⁾及びN.M.Rの測定⁽⁷⁾ 結果から推定した値ときわめてよく一致している。

3.5.2 出力の磁場依存性

共鳴SFR散乱の利得 g_s は既に述べたように、共鳴係数WとSFR散乱に寄与する有効電子数の変化に支配される。以下では、この実験で用いた結晶について、利得 g_s に影響を与える有効電

子数及び共鳴係数の磁場による変化について述べる。

2章で述べたように SFR 散乱に寄与しうる電子数の磁場変化はフェルミ準位の磁場依存性から考察できる。実験中の共振器温度は約10Kであるが、温度0Kを仮定し各ゼー

マン準位に対する電子占有確率(フェル ミ分布関数)を0または1で表わしても実験 条件との間に大きな相違は生じないと考えら れる。図-3.5.3に温度0Kを仮定して計算 したフェルミ準位の磁場による変化を示す。 但し、この図ではエネルギーの原点を価電子 帯上端にとった。また、計算では伝導電子 サイクロトロン有効質量 $m_c^* \approx B//<100 >$ の時の報告されている値 $m_c^*=0.0278m$ とし た $(_{o}^{(s)}(7)$ さらに、等エネルギー面の短軸方向 の有効質量 m_{\perp} はGreev らの提案した関係 _式(5)(4)

 $m_{\perp} = 0.1 4 6 E_g (eV) m$ (3.5.2)

により計算し、 $m_{\perp} = 0.0178m$ とした。 一方、等エネルギー面の長軸方向の有効質量 m_{\parallel} と m_{\parallel} の間には

 $m_{//} / m_{+} \simeq 11$ (3.5.3)



図-3.5.3 フェルミ準位の磁場依存性

の関係が成立つことが報告されており⁽⁵⁾⁽¹³⁾これに従って $m_{\parallel} = 0.196 m elc.$ 。以上 $m_{\parallel} em_{\perp}$ から状態密度有効質量 m_{d} $dm_{d} = 0.0396 m elt 算できる。磁場中のフェルミ準位の計算$ $には磁場と平行な方向に対する有効質量<math>m_{B}$ が必要であるが $m_{\perp} em_{\perp}$ から計算して $m_{B} = 0.114 m elc.$ 。さらにフェルミ準位を計算するのに必要な電子有効g値はこの実験から値た 20kGでの値56.8を用い、電子はブリリュアン帯端の等価は4つの谷に等しく分布していると 仮定し、エネルギー帯のnonparabolicity は無視した。 との計算から零磁場でのフェル ミ準位は伝導帯底から7.89meV(63.6 cm⁻¹)上に存在することになる。

図-3.5.3からフェルミ準位は磁場8kGと22kGでそれぞれランダウ準位量子数ℓ=1及び 0の準位に付属した↓スピン準位と交差することがわかる。これらの磁場では↑スピン準位の 電子数と↓スピン準位の電子数の差が極大となるため、ストークス光利得は極大値となる。この 図から↑スピン準位と↓スピン準位に存在する電子数の差は磁場と共に図-3.5.4に表すように変 化することが計算できる。図-3.5.4に示した規格化した電子分布差Sは次式によって定義される。

$$S = \frac{N\uparrow - N\downarrow}{N} \qquad (3.5.4)$$



図-3.5.4 電子分布差の磁場依存性

但し、N \uparrow とN \downarrow はそれぞれすべての伝導帯 \uparrow スピン準位と \downarrow スピン準位に存在する電子密度 を表わす。また、Nは全伝導電子密度を表わし N=N \uparrow +N \downarrow である。(3.4.5)式で定義し たSはストークス光発生に寄与しうる電子数の 全伝導電子数に対する割合を表わす。この図か ら22kGより高磁場ではS=1であり、すべ ての伝導電子は \uparrow スピン準位に存在することが わかる。

一方、磁場が22kGより小さい場合、電子 分布差の示す変化はこれまでInSb(0K) について報告されている結果⁽¹⁴と大きくこ となるようになる。 n-InSb では、フェル ミ準位が(1、 ↑) スピン準位と(1、↓)

スピン準位の間に存在する時、分布差Sは磁場の変化につれて急激な変化を示すが(40)(6) Pb_{0.88}Sn_{0.12}Teでは、フェルミ準位がこれらの準位間に存在する磁場範囲(9kG~16kG)で は分布差Sは比較的ゆるやかに変化する。InSb と PbSnTe でこのような相違が生じる原因 は PbSnTe は InSb より大きな電子有効質量と有効g値をもつことによると考えられる。

一方、共鳴係数Wは、励起光光子エネルギーが共振器禁制帯幅に近づくにつれて急激に 増大する。しかし、励起光波長を固定すると共振器禁制帯幅は磁場と共に増加するため、

10³

共鳴係数は磁場の増加と共 に次第に減少するようにな る。この実験で用いた励起 光周波数に対する共鳴係数 Wの磁場による変化を図 -3.5.5 に示す。



ストークス光利得 g_s は 上記の2つの要素電子分布 と共鳴係数を通じて磁場依 存性をもつが、出力光がレ ーザーとなるためには

$$g_s \ge \alpha_s + \frac{1}{\ell} \ln R$$

(3.5.5)

-32-

が成立することが必要である。ここで*Q*。はストークス光の吸収損失係数を表わす。この発振条件 に影響を与える要素には励起光及びストークス光に対する共振器内部での吸収損失がある。この損 失としては InSb 共振器の場合と同様に自由電子による吸収、及び高次のサイクロトロン周波数 及びこれに光学フォノン周波数が加わった周波数で発生する共鳴吸収損失が考えられる。励起光に 対するこれら吸収損失はストースク光利将に影響を与えるが、共鳴条件を満たすために励起光光子エネル ギーをベンドギャップに接近させた場合には吸収端及びUrbach-tailによる吸収が増加すること も考慮しなければならない。また、この励起光の吸収損失も磁場と共に変化する。以上述べたこと から共鳴条件下でのストークス光出力は、非共鳴の場合よりも励起光波長と磁場により敏感に影響 されることが予測できる。

(ストークス光出力の励起光周波数依存性)

前項で述べたことから磁場を固定するとストークス光利得に影響を与える要素は共鳴係数Wの励 起光周波数による変化のみになることがわかる。励起光周波数を10.67 µmから10.33 µmま で変化した時のストークス出力の変化を図-3.5.

6に示す。図中には共鳴係数Wの 変化も同時に示している。この図 から、励起光周波数が950 cm⁻¹ (10.53 µm)より低い領域ではス トークス光出力はいずれの磁場に ついても同様に励起光周波数の増 加につれて増大することがわかる。 しかし、励起周波数が950 cm⁻¹ より高くなると出力はかえって減少 するようになるが、その減少の度合 は磁場の増加と共に小さくなる。しか し、共鳴係数Wが図-3.5.6 に示した ように励起光周波数と共に増加するこ とから励起周波数950 cm⁻¹ 以下の



図 - 3.5.6 ストークス光出力(実測値)の励起光 周波数依存性と共鳴係数(計算値)の 励起光周波数依存性

領域で観測される励起周波数の増加に伴ったストークス光出力の増加は共鳴効果により利得g_sが 増加するために生じると考えられる。一方、励起周波数が950 cm⁻¹ を超え た場合の出力の減少 は励起周波数が吸収端に接近することにより、共振器内部での励起光吸収損失が増加するため(図 - 3.5.10)生じると考えられる。今のところ950 cm⁻¹以上の励起光周波数領域で生じるストー クス光出力の変化を共鳴効果と励起光吸収損失の変化のみで説明 できるとは断言できないが 図-3.5.7 に示すように、励起光の共振器透過光が磁場と共に増加することから吸収端による励 起光の吸収損失は磁場の増加に伴って減少するこ とがわかる。この吸収損失の減少は図 - 3.5.5 -6 に示した共鳴係数の減少よりも支配的にストー クス光出力に影響を与えるため、図 - 3.5.6 に示 した960 cm⁻¹以上でのストークス光出力の減少 が高磁場となるにつれて小さくなると考えられる。 次節で励起光の吸収損失の増加を考慮した時のス トークス光出力を見積るが、その結果からもその推 定が定性的には正当であることが示される。なお、 図 - 3.5.7 に示す 励起光の共振光の共振器透 過光は磁場 30 k G以上の領域で飽和する。この 飽和は励起光周波数が高次のサイクロトロン周波



数と一致し共鳴吸収損失が発生するためとも考えられるがその原因は今のところ明らかでない。

(出力の磁場依存性)

ストークス光出力は励起光周波数と磁場 に依存する。図-3.5.8に励起光周波 数を10.53,10.59,10.67µmと変化した場 合のストークス光出力の磁場依存性を示す。 ストークス光出力は15kGから18kG付 近でピークとなるがピークでのストークス 光出力は励起光周波数を増加するにつれ増 大することがわかる。この出力の増大はす でに述べたように共鳴効果によって利得が 増加するためと考えられる。一つの励起光 波長に着目すると出力は15kG付近でゆる やかなピークを示す。この場合ストー



図-3.5.8 ストークス光出力の磁場依存性

クス光利得の磁場依存性に影響を与える要素としては電子分布差、共鳴係数及び励起光の 共振器内部での吸収損失の3つが考えられる。電子分布差はストークス出力がピークとなる磁場付 近ではフェルミ準位が図-3.5.3 に示したように(1,↑)準位と交差するため、図-3.5.4 に示し たように変化する。図-3.5.4 に示した分布差の磁場依存性は温度 T = 0 K についての計算である が実験温度10 K ではこの仮定から少しずれて磁場と共にゆるやかに増加するようになっている可 能性もある。 ストークス光出力のピークよりも低磁場側で磁場の増加と共に出力が増加する 理由は今のところ明確ではないが、電子分布差が増大することも考慮する必要がある。

-34--

他方、ストークス光出力のピークよりも高磁場側で磁場の増加と共に出力が減少する原因は図-3.5.4 に示した分布差の変化からは説明できない。 ストークス光出力が16kGより高磁場で減少する原因としては図-3.5.5 に示した共鳴係数が磁場と共に減少しストークス光利得を減少させること及び磁場と共にストークス光波長が増加し、ストークス光に対する共振器内部での自由キャリアによる吸収損失が増加すること⁽¹⁹⁾、さらに高磁場となるにつれストークス光及び励起光に対する高次のサイクロトロン共鳴吸収損失⁽⁰⁾が増加すること、等が考えられるが、今のところ明らかではない。



図-3.5.9 ストークス出力の磁場依存性

図-3.5.9に励起光波長を10.53 µm より短波長側に変化した時のストークス 光出力の磁場による変化を示す。 励 起光周波数を増加するにつれストークス 光出力が観測される磁場が高磁場側にシ フトすることがわかる。 このシフトの 原因は低磁場では 励起光周波数の増 加と共に吸収端の影響で励起光に対する 吸収損失が増加し (図-3.5.10)共 鳴効果による利得の増加を上回るように なり、ストークス光の発振が抑制される ためと考えられる。しかし、励起光に対 する吸収損失は磁場が増加するにつれ減

少するようになる。この時、共鳴係数も減少するが、共鳴係数の磁場依存性は吸収損失の変化より はゆるやかであるため磁場の増加と共に、ストークス光の発振が可能になると考えられる。以上の 理由により励起周波数の増加と共に発振開始磁場が高磁場側にシフトすると考えられる。

3.5.3 出力の磁場依存性の解析

光共振器内で励起光が基礎吸収によって吸収される時、利得も共振器内で空間的に変化する、その時、共振器内部でのストークス光強度 I。は位置の関数となり

$$\frac{d I_{s}(x)}{d x} = (g_{s} e^{-\alpha} x - \alpha_{s}) I_{s}(x) \qquad (3.5.6)$$

で与えられる。ここでxは共振器の励起側端面からの距離、 g_s はx=0でのストークス光の利得で あり(2213)式で与えられる。この実験では利得は共鳴効果の大きさに依存して急激に変化する項を含 むため(2.2.13)式の g_s から共鳴効果によって変化する項(共鳴係数W)を取出し $g_s = g_0 W$ と表わすことにする。また、 α_o は励起光の共振器内部での基礎吸収による吸収係数を表わし、 α_s はストークス光に対する吸収係数である。共振器長を ℓ とすると共振器励起側端面から距離 ℓ 進んだ後のストークス光強度 $I_s(\ell)$ は

$$I_{s}(\ell) = I_{so} e xp \left[\left\{ \frac{g_{s}}{\alpha_{o} \ell} \left(1 - e^{-\alpha_{o} \ell} \right) - \alpha_{s} \right\} \ell \right]$$
(3.5.7)

と表わされる。共振器端面での反射率をRとするとストークス光がレーザー発振を開始するために は、ストークス光が共振器内部で1 往復した時

$$\mathbb{R}^{2} \cdot \mathbb{I}_{so} \exp \left[\left\{ \frac{g_{s}}{\alpha_{o}\ell} \left(1 - e^{-\alpha_{o}\ell} \right) - \alpha_{s} \right\} 2\ell \right] \ge \mathbb{I}_{so} \qquad (3.5.8)$$

となる。

この発振条件は

$$\mathbf{g}_{s} \geq \frac{\boldsymbol{\alpha}_{o}\boldsymbol{\ell} \quad (\boldsymbol{\alpha}_{s} - \frac{1}{\boldsymbol{\ell}} \quad 1 \text{ n R})}{(1 - e^{-\boldsymbol{\alpha}_{o}\boldsymbol{\ell}})} \qquad (3.5.9)$$

と変形できるが、この式は励起光の吸収を考慮しない場合のレーザー発振条件(2.5.7)に対応す る。利得が損失を超える割合 Pを

$$P = \frac{g_{s} (1 - e^{-\alpha} o\ell)}{\alpha_{o} \ell (\alpha_{s} - \frac{1}{\ell} \ln R)}$$
(3.5.10)

によって定義すると、レーザー出力 I_s は 2 章で述べたように、 励起中のスピン準位間の電子の緩 和を無視し、励起光強度分布をガウス分布で近似すると

$$I_{s} = A (I_{n}P + \frac{1}{P} - 1)$$

で表わされる。

実験温度13Kでの励起光に対する共振器 吸収係数を図-3.5.10に示す。但し、この 値は零磁場での値である。磁場中では図-3. 5.7に示したように励起光の共振器透過強度 は磁場と共に増加するようになるが、励起光 吸収係数そのものは磁場によってほとんど減 少しない。そのため(3.5.10)の計算に零



-36-

磁場での吸収係数を用いても大きな誤差は生じないと考えられる。また、ストークス光に対する吸収係数 Ω_s 及び共振器端面での反射率Rをストークス光の波長変化に対して一定と仮定すると、(3.5.10)は図-3.5.10より exp $(-\Omega_0\ell)$ 《1、であるから

$$P = \frac{g_{o}W(1 - e^{-\alpha_{o}\ell})}{\alpha_{o}\ell(\alpha_{s} - \frac{1}{\ell} \ln R)} \simeq \frac{g_{o}W}{\alpha_{o}\ell(\alpha_{s} - \frac{1}{\ell} \ln R)}$$
(3.5.12)

と表わされる。ストークス光利得が共振器内の全損失を超える割合 Pは励起光周波数が共振器禁制 帯幅に接近するにつれて増大する共鳴係数W(図-3.5.6)と励起光吸収係数 Ω_0 (図-3.5.10) の大きさにより変化することになる。(3.5.12)で表わされるPを用いて(3.5.11)から計算 したストークス光出力の励起光周波数依存性を図-3.5.11に示す。但し、この計算ではAとPを バラメータとし、ストークス光出力 I_sを励起光周波数 950 cm⁻¹(10.53 μ m)及び 944 cm⁻¹(10.59

µm)の時の実験値と一致するようにした。 図-3. 5.11に示したように計算値と実験値との定量的な 一致はあまり良くないが、定性的には励起光周波数 が増加し、吸収端に接近するようになると励起光の 吸収損失が増加し、共鳴効果による利得の増大を上 回るようになるためストークス光出力の減少が生じ ることがわる。

図-3.5.11には励起光の吸収損失が存在しない 時のストークス光出力の計算値も同時に示している。 励起光の吸収損失が存在しない時にはストークス光 出力は実験値よりも1桁程度上昇すると考えられる が、共鳴効果による出力の急激な増加は励起光周波 数が共振器禁制帯幅に接近した場合に生じることが わかる。

以上述べたことから図 - 3.5.1 1 に示したストー クス光出力が励起光周波数950 cm⁻¹以上で減少す る原因は励起光の吸収が増加し、共鳴効果による利 得の増大を上回るため生じた可能性が強い事が結論 づけられる。



図-3.5.11 ストークス光出力の励起 周波数依存性

§ 3.6 今後の問題点

以上、本実験を通じて得られた $n-Pb_{0.88}Sn_{0.12}Te~SFR \nu-ザーの基礎発振特性を述べた。$ このレーザーは現時点では共振器用の良質な結晶作製が困難であるため十分な実用性があるとは言いがたいが、今後、結晶成長技術が進歩するにつれ実用性が増加すると考えられる。また、共振器キャリア密度低減化や平行度改善により連続発振も実現可能と考えられる。

波長10μm領域の連続発振SFRレーザーとしては現在HgCdTe三元混晶が用いられるが この材料と比較してPbSnTeは以下に述べるSFR共振器としての長所を持つため将来は重要 な共振器材料として活用されると考えられる。

- 1) PbSnTe混晶系のPbの組成が多い結晶では伝導帯と価電子帯の構造は低温に於て禁制帯 中央に対して対称的となり、伝導電子と正孔は共に等しい有効質量と有効g値をもつ。⁽⁴⁾⁽⁵⁾ このため、本実験で得たと同様な大きいストークス光の同調率がP形材料についても期待できる。 従って、共振器としてInSbやHgCdTeのようにn形材料のみに制限されない。
- 2) PbSnTeの有効g値は磁場と<111>軸のなす角度によって変化するため、出力光の波 長変化は磁場の大きさの変化だけでなく、磁場と<111>軸とのなす角度を変化することに よっても行うことができる。従って、PbSnTe共振器では磁場源として永久磁石を使用し、 磁場と<111>軸との角度を変えることによっても出力光の波長を変化できるため、SFR レーザー装置の小型化が可能になる。

§ 3.7 結 言

TECO₂ レーザー励起 n-Pb_{0.88}Sn_{0.12}Te SFR レーザーの発振に初めて成功し、以下の基 礎発振特性を得た。

- 1) ストークス光のレーザー発振励起しきい値強度は磁場16kGにおいて0.6MW・cm⁻²である。 また、最大出力は磁場16kGで得られ、約6.6mWとなった。この時励起光からストークス光 へのパワー変換効率は約3×10⁻⁶%であったが、そのように効率が低い原因は共振器平行度 が低い事、及び共振器内の伝導電子密度が10⁴cm⁻³と高いことにより自由キャリアによる光吸 収損失が大きいことが考えられる。
- 2) 励起光として10.54 µmを用い、磁場を<100>軸方向に印加した時、磁場8kGから41kGの範囲 でストークス光が観測され、波長は10.82 µmから11.78 µmまで変化する。この時、単位磁場当りの ストークス光同調率は2.65 cm⁻¹・kG⁻¹となり、n - I n S b の約1.3 倍となった。この同調率 は磁場を<1111>軸方向に印加した場合にはさらに増加し、約4.2 cm⁻¹・kG⁻¹に達するも のと見積られる。
- 3) ストークス光出力は励起光周波数を940cm⁻¹から950cm⁻¹と増加するにつれて増大する。この出力の増加は共鳴効果により利得が増大するため生じると考えられる。一方、励起光周波数を950cm⁻¹以上とした場合には出力の減少が生じる。この出力の減少は励起光周波数が共振器禁制帯幅に接近するため励起光の吸収損失が急激に増大し、共鳴効果による利得の増大を上回

るため生じると考えられる。

- 4) ストークス光出力は磁場の増加と共に増大し、磁場16kG付近でピークとなる。この出力の 増大は磁場と共にストークス光発生に寄与する電子の数が増加するためと考えられる。また、 磁場16kG以上で生じるストークス光出力の減少は共鳴係数の減少によりストークス光利得 が減少すること及びストークス光に対する高次のサイクロトロン共鳴吸収損失の発生によって 生じる可能性が強い。
- 5) ストークス光出力の励起光周波数による変化は励起光吸収係数と共鳴係数の変化を考慮することにより定性的に説明できる。

参考文献

- 1) J.O.Dimmock, I.Melngailis and A.J.Strauss; Phys. Rev. Letters <u>16</u> (1966) 1193.
- J.P.Sattlel, B.A.Weber, J.Nemarich; Appl. Phys. Letters
 <u>25</u> (1974) 491, <u>27</u> (1975) 93.
- K.Yasuda and J.Shirafuji; Appl. Phys. Letters <u>34</u> (1979) 661.; Jpn. J. Appl. Phys. 19 (1980) 1135.
- 4) J.F.Butler; Solid State Commun. 7 (1969) 909.
- D.M.Greev, I.I.Zasavitskiĭ, B.N.Matsonashvili and A.P.Shotov; Sov. Phys. Semicond. <u>12</u> (1978) 411.
- A.R.Calawa, T.C.Harman, M.Finn and P.Youtz; Trans. AIME <u>242</u> (1968) 374.
 D.Long and J.L.Schmit; 'Semicond. and Semimetals' <u>5</u> Ch. 5 (Academic Press, 1970)
- C.R.Hews, M.S.Adler and S.D.Senturia; Phys. Rev. <u>7</u> (1973) 5195.
- 8) C.K.N.Patel and E.D.Shaw; Phys. Rev. 3 (1971) 1279.
- 9) J.O.Dimmock; J. Chem. Solid suppl 32 (1971) 319.
- J.R.Burke, B.Houston and H.T.Savage; Phys. Rev. <u>B2</u> (1970) 1977.
- 11) 川村肇: "固体物理学"共立全書169(共立出版、1971)P170
- 12) C.K.N.Patel and R.E.Slusher; Phys. Rev. <u>177</u> (1969) 1200.
- D.M.Greev, I.I.Zasavitskii, B.N.Matsonashvili and A.P.Shotov; Sov. Phys. Semicond. <u>12</u> (1978) 1032.
- R.B.Dennis, C.R.Pidgeon, S.D.Smith, B.S.Wherrett and R.A.Wood; Proc. R. Soc. London <u>A331</u> (1972) 203.

- 15) B.S.Wherrett, S.Wolland, C.R.Pidgeon, R.E.Dennis and
 S.D.Smith; Proc. Intn. Conf. Phys. Semicond. Stuttgart,
 1974 (ed. B.G.Teubner, Stuttgart, 1974) p. 793.
- 16) E.S.Wherrett and P.G.Harper; Phys. Rev. <u>183</u> (1969) 692.
- 17) K.J.Eutton, B.Lax, M.H.Weiler and M.Reine; Phys. Rev. Letters <u>17</u> (1966) 1005.
- 18) H.R.Riedl; Phys. Rev. <u>127</u> (1962) 162.

第4章 n-InSb SFRレーザー出力及び励起光透過波形 の時間的変化

§4.1 緒 言

n-InSbSFRレーザー出力はすでに2章(図-2.4.1)で述べたように励起光強度約2MW cm⁻²で飽和する傾向を示す。励起強度をさらに増加すると出力はかえって減少するようになり、励 起光がストークス光に変換される効率すなわちパワー変換効率は励起強度の増加と共に減少するよ うになる。⁽¹⁾また、変換効率が低下する高励起時にはストークス光出力波形および励起光の共振器 透過光波形(以下透過光と略記する)は励起光波形と相似とはならず、励起光波形のピークではか えって減少する現象を示す。⁽¹⁾

このようなSFRレーザー出力及び透過光の減少が生じる原因として、これまで提案されたモデ ルを簡単にまとめると次のようになる。

- 1) InSbの正孔は波長10µm付近の赤外光を吸収して価電子帯間で遷移するため伝導電子と 比較して大きな光吸収断面積(215倍、77K)をもつ。⁽²⁾ SFRレーザーの励起時のよう な強い入射光のもとでは2光子励起によって、価電子帯から伝導帯に電子が励起されるように なり、価電子帯に正孔が生成される。その結果、励起光は正孔に強く吸収されるようになり、 透過光やストークス光に非線形な減少が生じる。⁽³⁾⁽⁴⁾
- 2) 伝導電子が励起光を多光子吸収し、伝導帯の高エネルギー状態に励起される。(ホットエレクトロンになる) この電子がエネルギー緩和過程で価電子を衝突電離する。この結果伝導電子数が過渡的に増加し、励起光を吸収する。⁽⁵⁾
- 3) 励起光電界で加速された伝導電子が衝突電離によって価電子を伝導帯に励起する。この時、価 電子帯に生成された正孔が励起光を吸収する。⁽⁶⁾⁽⁷⁾

これら3つの機構ではいずれも励起光によって伝導電子及び正孔が生成される事を前提としている。 しかし、これまでSFRレーザーの動作温度(約10K)のような低温で、波長10.6 μm帯の励 起光によりキャリアが生成される事実は直接確認されておらず、さらに入射光に対するこの温度での 正孔の吸収断面積も測定されていなかった。そのため先に述べた光吸収機構の実験的な裏付けはな かった。一方、SFRレーザーの高効率・高出力化といった実用上の観点からは、レーザー共振器 中に生じる非線形な光吸収の発生機構を解明し、これを防止することが重要である。

このような観点から本章ではSFRレーザー出力の減少や透過光強度の減少機構の解明を目的と して行なったこれら光信号の時間的変化の測定について述べ、 さらに正孔の吸収断面積の測定 結果及び励起光入射時の光電導度の測定結果から光吸収機構を論じる。 §4.2 SFRレーザー出力及び励起光透過特性の時間的変化

4.2.1 実験装置及び実験方法

本実験で使用した n-InSbSFR共振器は電子密度 2.3×10^b cm⁻³ (77K)で寸法は 8×5×9.5 mm³ である。8×5 cm² の 2 面は平行度 1 2 秒以内平面度 λ /5 (λ はNa・D線波長 58 9nm)に研磨 しSFR共振器は 50 kG超電導マグネット内部に取付け実験中は約10Kに冷却した。

実験装置のブロック図を図-4.2.1 に示す。図中には後に4.3 節で述べる光電導 度測定で用いたn-InSb結 晶の形状や実験装置も同時に CRYOSTAT InSb SAMPLE 10-13K

示している。

装置の大部分はすでに2 章および3章で述べたもの と同様であるため、ここで は重複を避け異なっている 箇所についてのみ述べるこ とにする。

InSb SAMPLE 10-13K TE CO2 LASER εŢ P«R Ge:Au [Ge:Hg 30K 77K LASER POWER SUPPLY MONOCRO MATOR DELAY CIRCUIT TRIGGER LIGHT DUAL BEAM OSCILLO. 54 In CONTACT mm

SFR共振器に入射する CO₂レーザー光パルス波形及

図-4.2.1 実験装置

びピーク強度は77Kに冷却したAuドープGe光導電素子によってモニターした。また、SF Rレーザー出力及び透過光の変化は30Kに冷却したHgドープGe光導電素子によって検出した。 これら二つの検出器の出力は2現象オシロスコープにより同時に観測した。

Ge:Au及びGe:Hg検出器のCO₂レー ザーバルスに対する応答特性を図-4.2.2 上段及び下段に示す。図から信号検出に使 用したHg:Ge検出器はCO₂レーザーのモ ードロックバルスにも追従可能であること がわかる。一方、Ge:Au検出器は応答速 度に制限されてモードロックバルス波形の 飽絡線に相当する信号を示す。これらの特 性の相違は後の測定に全く支障はない。

なお、次節に示す透過光波形は分光器ス リットにより減衰させて測定を行ない、 Ge:Hg検出器の飽和を避けた。



図 - 4.2.2 Ge : Au , Ge : Hg 光検出器の 応答特性

4.2.2 実験結果と検討

励起CO₂ レーザー (10.59μm)バルスの波形とストークス光出力波形をそれぞれ図 - 4.2.3の上



ークス光出力もストークス光出力と同様な変化を示す。

このようにストークス光出力と反ストークス光出力が同様な振舞を示す事は、SFRレーザー 出力が励起強度ピークでかえって減少する現象がストークス光発生に伴って電子分布差が過渡的 に減少するために生じるのではないという事を示している。

一方、同様な実験条件では、図-4.2.4 に示すように透過光も励起光強度の増加に伴って減少す



SFRレーザーのパワー変換効率からも、励起光がSFR出力に消費されたとは考えられない。

図-4.5.2は入射光波長10.67 µm において測定したピーク 入射 光強度に対する透過光強度の変化 を示している。この測定で使用し たn-InSb の電子密度は4× 10¹⁵cm⁻³(77K)で結晶長は 9.9mm である。また、測定温度はSFR レーザー動作温度とほぼ等しい13 Kである。この図から透過光強度 は入射光強度が 1.4 MW・cm⁻² を超 えると減少し始め、この入射光強 度以上では結晶内部に非線形な光 吸収機構が発生し、入射光を吸収 するようになることがわかる。こ の入射光強度は図-4.2.3及び図 - 4.2.4 に示した透過光やストー



クス光の異常が生じる入射光強度とほぼ一致している。

以上述べてきた非線形な光吸収の発生機構を考察するためには、緒言でも触れたように入射光に よって、価電子帯に正孔が生成された時の光吸収に対する影響を正確に見積ることが必要と考えら れる。なぜならば、以前から正孔は低温では重い価電子帯から軽い価電子帯に遷移することによっ て波長10μm付近の赤外光を強く吸収するようになることが指摘されており、⁽²⁾入射光によって 生成された正孔は、その密度は小さくともその後入射光を吸収して非線形現象をもたらすことが考 えられるからである。しかし、正孔の光吸収断面積は温度300Kから77Kの範囲で測定されて いるだけであり、この実験を行った温度(13K)での値は不明であった。

測定試料としては正孔密度 $\ln p \cdot 2 \times 10^{16} \text{m}^{-3}(13 \text{K}) \circ p - \ln \text{Sb}$ 単結晶を用い、波長 $10.67 \mu \text{m}$ 光 に対する透過強度から吸収係数 $\Omega \in \mathbb{R}_p \cdot \sigma_p \circ p$ の関係から正孔 $1 \circ 2 \to 0$ の吸収断面積 $\sigma_p \circ p$ 当した。但し、入射光強度は 1 kW/cm^2 であり、この入射光強度では透過光に非線形な吸収は観測されない事を確認した。この測定から温度 1.3 K では正孔の吸収断面積 σ_p は伝導電子のもつ値より 1400 倍程度大きく、 $\sigma_p = 3.4 \times 10^{-14} \text{ cm}^2$ であることが明らかになった。低温で正孔の吸収断面積が大きくなる理由は、価電子帯内での遷移に際してフォノンにより散乱される割合が減少するためと考えられる。

このように正孔の吸収断面積が大きい事からSFRレーザーの動作温度では共振器中にわずかな 数の正孔が発生しただけでも励起光はこの正孔によって吸収され得る事がわかる。

-45-





§4.3 CO2 レーザー光による光電導特性

前節では非線形な光吸収を示唆するSFRレーザー出力及び透過光の時間的変化について述べ、 励起光によって生成された正孔が関与する可能性について論じた。しかしながら、励起光によっ て正孔が生成されるという直接的な確認及び正孔の生成過程についての実験的な考察は行なっていなかった。 この節では、励起CO2レーザー光に対するn-InSbの光電導度の測定結果について述べ、この 測定結果から正孔の生成過程についての考察を行ない、さらに非線形な光吸収機構について述べる。

4.3.1 実験装置及び実験方法

 $CO_2 \nu$ ーザー光による光電導度測定の試料として用いたn-InSb単結晶は電子密度 1.8×10^{15} cm⁻³ (77K)である。この結晶は $CO_2 \nu$ ーザー光入射端面を鏡面に研磨した後、図-4.2.1 に示したように = の字形に加工し、Inを合金してホーム性電極を形成した。実験中電極部分はアルミ板でおおい、わずかに整流性が残る際に入射光によって生成された少数キャリアが電極部に注入されて光起電力を発生するのを防止した。

試料は光学測定用クライオスタットのコールドフィンガーに取付け実験中は13Kに冷却した。 試料には直流電流を印加し励起光入射時に試料両端に生じる電圧変化を検出した。この光電導度 信号とGe:Hg検出器で測定した励起光波形は2現象オシロスコープにより、同時に波形観測を行なっ た。なお、励起光として用いたCO。レーザー光波長は前節と同様10.59 μm及び10.67 μmである。

-46-

4.3.2 実験結果と検討

図-4.3.1 (a, b)に2種の 時間スケールで観測した入射CO。 レーザー光波形(同図-上段) とn-InSbが示す光電導波形 (同図-下段)を示している。 図に示した入射光は10.67 µm

度信号は入射光によって結晶中 にキャリアが生成されて、電極 間の抵抗が低下するため生じて おり、励起光によってSFR共 振器中にキャリア (電子-正孔 対)が生成される事を直接裏付 けている。また、結晶中には同数の 電子と正孔が生成されるが、InSb では正孔の移動度は伝導電子の 5%以下であるため、この光電 よって成立つと考えられる。

図-4.3.1から光電導度は入 射光強度ピークと一致して最大 となり、その後はゆるやかに減 衰することがわかる。この減衰



100nS/div.



の時定数はピーク入射光強度6MW・cm⁻²以下では入射光強度の増加と共に短くなる傾向を示し、 1.3 µ s から 0.4 µ s まで変化する。この時定数は Fossum らが 77K で測定した値 730 n sとほぼ一 致している。(8) 減衰時定数が入射光強度によって変化する理由は生成されたキャリアの再結合機構 が2分子再結合であるためと考えられる。Fossumらは2光子励起が強く生じる波長9.6 μm の入射光では入射光強度を増加し生成キャリア数を増加させるとキャリアの緩和過程が1分子再結 合過程から2分子再結合過程に移行する事を指摘しているが⁽⁸⁾本実験からはその事を明確に確認で きなかった。

光電導度の測定結果と電子移動度から入射光によって生成されるキャリア数を求める事 が可能である。ホール効果から求めた電子移動度を用いて、図-4.3.2 に入射光波長 10.67 µmと10.59 µmについて測定した生成キャリア密度の入射光強度による変 化を示している。図中には後に述べる計算値を同時に実線で示している。また、図中

-47-

縦軸に示したキャリア密度 は結晶長についての平均値 である。

この図から、生成キャリア 密度の増加は光子エネルギ ーの大きい10.59µmの 方が10.67µm光より急 激である事がわかる。この ような生成キャリア密度の 入射光波長依存性はキャリ アの生成機構が2光子励起 である事を示すものと考え られる。なぜならば、他の キャリア生成機構として提 案されている入射光の多光 子吸収、あるいは電界加速 によりホットエレクトロン



となった伝導電子の衝突電離過程では生成されたキ

ャリア密度はこのような顕著な入射光波長依存性を示さないと考えられるためである。

前節で述べた正孔による入射光吸収と2光子励起によるキャリアの生成を仮定すると、結晶の入 射端面からの距離xの位置で生成されるキャリア密度 / n と入射光強度 I の変化は次のレート方程 式によって記述できる。

$$\frac{d(\Delta n)}{dt} = \frac{K_2 I^2}{2\hbar\omega_0} - \gamma \Delta n - \beta \Delta n^2 \qquad (4.3.1)$$

$$-\frac{d I}{d x} = K_1 I + K_2 I^2 + \Delta n (\sigma n + \sigma_p) I$$
 (4.3.2)

ここで、 $h \omega_0$ は入射光光子エネルギー, $K_1 \ge K_2$ はそれぞれ1光子と2光子吸収の吸収係数、 $\gamma \ge \beta$ はそれぞれ1分子と2分子再結合係数である。しかし、 $4 n \ge I$ は時間 t 及び入射端面からの距離 xの関数であるため連立微分方程式を解いて $4 n \ge I$ の解を直接求める事は困難である。そこで 次の仮定を行ない近似解を求める。

図-4.3.1 に示した入射光と光電導度信号の波形から入射光パルス幅 d t の間のキャリアの再結 合は無視できると仮定し入射光パルスを幅 d t の矩形波で近似する。このとき、生成キャリア密度 d n d (4.3.1)式から

$$\Delta n \simeq \frac{K_2 I^2}{2 \hbar \omega_0} \Delta t$$

と表わすことができる。

また、(4.3.2)式で正孔の吸収断面積 σ_p は電子の断面積 σ_n よりも3桁程度大きい事から σ_n を無視する。このようにして端面からの距離 x でのキャリア密度と入射光の強度として

$$\Delta \mathbf{n} (\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{K}_2 d \mathbf{t}}{2 \hbar \omega_0} \left[\frac{\mathbf{K}_2 \sigma_p \Delta \mathbf{t}}{\hbar \omega_0} \mathbf{x} + \mathbf{I}_0^{-2} \right]^{-1}$$
(4.3.3)

$$I(x) = \left[\frac{K_2 \sigma_p \varDelta t}{\hbar \omega_0} x + \Gamma_0^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$$
(4.3.4)

を得る。但し、Ioは入射端面での光強度である。これらの式から入射光によって生成されるキャリア 密度は入射光が正孔によって生成されるため端面から離れるにつれて小さくなる事及び入射光強度 はxに対して指数関数的な減衰を示さないことがわかる。

(4.3.3)式で得られるキャリア密度を結晶長ℓで平均する事により光電導度の測定から得たキャリア密度 4 Nと対応づけることができる。

この時、⊿Nは

$$\Delta N = \frac{1}{\ell} \int_{0}^{\ell} \Delta n(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$
$$= \frac{1}{2 \ell \sigma_{p}} \ln \left[\frac{(K_{2} \sigma_{p} \Delta t \ell / \hbar \omega_{o}) + \Gamma_{o}^{2}}{\Gamma_{o}^{-2}} \right] \qquad (4.3.5)$$

また、透過光の強度は(4.3.5)から

$$I(\ell) = \left[\frac{K_2 \sigma_p \Delta t}{2\hbar\omega_0} \cdot \ell + \Gamma_0^2\right]^{-\frac{1}{2}}$$
(4.3.6)

で表わされる。(4.3.5)式で表わされるキャリア密度 4 N は入射光強度の増加に対して明白な飽 和特性を示さないが、光電導度の測定から得た結果に対して K₂と σ_pの値をバラメーターとして適 合させる事ができる。

10.67 μ m光に対して K_2 の値を1.1×10⁻³cm・MW⁻¹, 10.59 μ m光に対して 2.3×10⁻² cm MW⁻¹ とし σ_p を 4.2×10⁻¹⁵cm⁻² とした時、図 - 4.3.2 に実線で示した最良の一致が得られた。但し、結 晶長 ℓ は8nm、入射光バルス幅を100 nS、光子エネルギー h ω_0 を、117 meV(10.59 μ m) 116meV(10.67 μ m)とした。

この計算から得られる正孔の吸収断面積 σ_p は前節で述べた吸収係数から得た値($3.4 \times 10^{-16} \text{cm}^2$) より1桁程度小さい値となる。この相違は計算上生成キャリア緩和を無視した事により入射端面付 近の正孔数を実際より多く見積りすぎるようになり生じたものと考えられる。しかし、この値は、 Krunickが77Kの正孔の断面積として報告した値 $5 \times 10^{-15} \text{cm}^{2(2)}$ と同程度であり、ここで行った 近似の程度から考えて得られた値として妥当なものと考えられる。⁽¹²⁾

一方、 K_2 の値については、これまで報告されている300Kから77Kまでの温度領域での測定 値15cm·MW⁻¹ ~ 0.02cm·MW⁻¹よりは、はるかに小さい。⁽⁹⁾⁽⁰⁾⁽¹⁾ これは300Kではバンドギャ ップ幅は 0.17 eVであるが、この測定を行なった温度10Kでは 0.23 eVとなるため2光子励起の 発生する確率が小さくなるためと考えられる。

この計算から得た K_2 及び σ_p を用いて(4.3.6)式から透過光強度の入射光強度による変化を計算できる。しかし、その結果では透過光強度は入射光強度 $2MW \cdot cm^{-2}$ 以上でゆるやかを飽和を示し、図-4.2.5 でみられるような高入射光強度領域での透過強度の減少は説明できない。また、この結果は σ_p として吸収係数の測定から得た値を用いた場合も用様である。

このような実験結果と簡単なモデルに基く計算結果の相違の原因としては次のような事柄が考えられる。

- i)入射光強度2MW・cm⁻²以上では2光子励起以外の過程、例えば、衝突電離によるキャリアの 生成が発生するようになり入射光の吸収損失が急激に増大する。
- ii) 2光子励起によって生成された正孔の光吸収により結晶の温度が過渡的に上昇し、禁制帯幅の 減少が生じる。この結果、2光子励起によるキャリアの生成が高入射光領域では急激に増大す る。

i)または i) の過程が発生する場合でも入射光によって数多くのキャリアが生成され、それらキ ャリアによって入射光の吸収損失が生じるのは結晶の表面付近の微小幅の領域のみで、結晶の内部 では光強度は弱い励起強度の時と比較してあまり変化せず、従って、生成されるキャリア密度も低 とんど増加しないと考えられる。そのため、図-4.3.1 に示したように光電導度から得たキャリア 密度はほとんど増加しなくなった可能性がある。 i)または ii) のいずれの過程が発生しているか をここで行った実験の範囲から判別する事はできない。しかし、 ii) に述べた機構は入射光として ピコ秒バルスを用い、1 バルス当りのエネルギーを減少させ、バルス入射中に生じる結晶温度の上 昇を無視できる状態で透過光を測定する事により判定可能と考えられる。透過光強度は図-4.2.5 に示したように 1.4 MW・cm⁻² 程度の入射光強度から減少し始める。この事は減少を引きおこす過程 が明確なしきい値をもって発生する事を示している。 i) で述べた過程はしきい値をもっと考えら れるため、ii) で述べた過程よりは i) の過程が発生する可能性が強いと考えられる。

§4.4 結 言

n-InSbSFRレーザー出力及び励起CO2レーザー光の共振器透過光の時間的な変化を測定

-50-

- し、以下のことが明らかになった。
- 1) 励起光強度 1.4 MW・cm⁻²以上では、透過光波形及びSFRレーザー出力波形に非線形を減少 が生じる。
- ご 正孔の光吸収断面積は温度13K、波長10.67µmにおいて3.4×10⁻¹⁴cm²(伝導電子の 1400倍程度)の吸収断面積をもつ。
- 3) 励起CO2レーザー光によりn-InSb 共振器中に過剰の正孔が生成されることを光電導度の測定から確認した。また、光電導度の励起光強度依存性は2光子励起によって生成された正孔による励起光吸収を考慮することにより説明できる。
- 4) 励起光の共振器透過光及びSFR出力波形でみられる非線形な減少は2光子励起により生成された正孔が、励起光を吸収するために生じると考えられる。しかし、高励起領域では、2光子励起のみならず、しきい値をもつ他の励起過程によっても正孔が生成されていると思われる。

参考文献

- 1) J.F.Figueira, C.D.Cantrell, J.P.Rink and P.R.Forman; Appl. Phys. Letters 28 (1976) 398, 442.
- 2) S.W.Krunick and J.M.Powell; Phys. Rev. <u>116</u> (1959) 597.
- J.Dempsey, J.Smith, G.D.Holah and A.Miller; Opt. Commun. <u>26</u> (1978) 265.
- A.Miller, A.Johnston, J.Dempsey, J.Smith, C.R.Pidgeon and G.D.Holah; J. Phys. <u>C12</u> (1979) 4839.
- T.W.Nee, C.D.Cantrell, J.F.Scott and M.O.Scully;
 Phys. Rev. <u>B17</u> (1978) 3936.
- S.A.Jamison and A.V.Nurmikko; Appl. Phys. Letters <u>32</u> (1978) 482.
- S.A.Jamison and A.V.Nurmikko; Phys. Rev. <u>B19</u> (1979)
 5185.
- H.J.Fossum and B.Ancker-Johnson; Phys. Rev. <u>E8</u> (1973) 2850.
- J.M.Doviak, A.F.Gibson, N.F.Kimmitt and A.C.Walker;
 J. Phys. <u>C6</u> (1973) 593.
- 10) C.C.Lee and H.Y.Fan; Phys. Rev. B9 (1974) 3502.
- 11) H.J.Fossum and D.B.Chang; Phys. Rev. <u>B8</u> (1973) 2842.
- 12) K.Yasuda and J.Shirafuji; Jpn. J. Appl. Phys. (投稿中)

第5章 SFRレーザーのガス分析への応用

§ 5.1 緒 言

波長2µmから20µm の赤外領域には多くのガス分子に固有の振動・回転準位に対応した赤外吸 収帯が存在することはよく知られており⁽¹⁾ この領域の高分解スペクトロスコピーは分子構造の解 明やガス分析手段としてきわめて重要である。周波数可変レーザーの開発以前にはこの波長領域の単 色光源として 熱輻射を分光器によって単色化する方法が広く用いられてきた。しかし、この方法で 得られる単色光は輝度が低く、また、スペクトル幅が広いため、分解能を高めるため高性能の 分光器や高感度の光検出器を必要としたため、容易に高分解スペクトロスコピーを行うことはでき なかった。

このような状況にあって、1966年にゼーマン同調法によるHe-Ne レーザーを用いてガス分子の振動スペクトルを検出する実験が行なわれ、⁽²⁾ 周波数可変レーザーが高分解スペクトロスコピー用の光源としてすぐれた応用性をもつことが示された。しかしながらこのレーザーは周波数可変範囲が 0.2 cm^{-1} 程度と小さいため適用できる範囲が狭いという欠点があった。この欠点を克服した比較的広い周波数可変範囲をもつレーザーによる分光実験が1970年になってから本格化し、ダイオードレーザー⁽³⁾及びSFRレーザーによる分光実験⁽⁴⁾が相次いで実現され、現在では光混合⁽⁵⁾あるいは高圧ガスレーザー⁽⁶⁾等の周波数可変光源によって実験が行なわれるようになった。これらの周波数可変レーザーは指向性がよくコヒーレントで高輝度であり、非常に発振線幅が狭いという特徴があるため、これまでは不可能であった長距離光路や変調技術を用いる分光も可能となり、従来からの分光技術そのものにも変革を与え始めている。また、Saturation spectroscopy⁽⁷⁾のようにレーザー出現以前には不可能であった測定も可能となってきた。

この章では2章で述べた CO_2 レーザー励起n - I n S b S F R レーザーによるNH₃ ガス分子の吸収スペクトル測定について述べ、このレーザーのもつ発振線幅等の実用上の諸問題を検討する。

§ 5.2 実験方法

NH₃ガス吸収スペクトル測定に用いた 装置のブロック図を図 - 5.2.1 に示す。 InSb共振器として用いた結晶は長さ 5 mm及び8 mmで伝導電子密度 2.3×10¹⁶ cm⁻³(77K)である。励起光源及び超 電導マグネットはすでに2章で述べた装 置と同じであるため説明を省略する。分 光器によって励起光を除いた後のSFR レーザー光はSiビームスプリッターによ



図-5.2.1 ガス吸収スペクトル測定装置

り参照光と透過測定光に分離し、Hg:Ge光電導セルによってそれぞれの光を検出した。また、信 号検出器D₁からの信号はポクスカー積分器によって平均した後、XYコーダーのY軸に入れ、超電 導マグネットの磁場掃引信号をX軸として、磁場を連続的に変化しながら記録を行なった。

吸収スペクトル測定用試料として用いたNH₃ガスは市販のボンベ封入のものを用い、ガス圧力の 較正はHgマノメーター及びオイルマノメーターによって行なった。

§ 5.3 実験結果と検討

赤外域の吸収スペクトルが詳細に 調べられているガスの一つに NH。ガ スがある。SFRレーザーのガス分 析への応用として、種々の回転振動準位 の吸収スペクトルを測定した結果を 図-5.3.1~3 に示す。図中に示し た吸収線の同定は分解能 0.1 cm⁻¹ 回格格子分光器によって測定さ れた吸収のピーク位置を示している。 図-5.3.1 に示した s P (5.2)線 とsP(5.0)線は約0.2 cm⁻¹離れ ていることが知られているが、実験 結果では各々のピークを分離して検 出できないことがわかる。また、 a P-4線の吸収スペクトルをガス 圧力20 torr から200 torr まで 変化して測定した結果を図 - 5.3.4 に示す。但し、この図ではガ



図-5.3.1 NH3 ガスsP-5線吸収スペクトル

スセル中を真空(10⁻³ mm Hg)とした時の透過光強度を基準として%値を算出した。この実験で 用いたガス圧力の範囲では吸収線幅はガス分子間の衝突による広がりが支配的であり圧力に比例し て線幅も増加することが知られている。これまで報告されているNH₃ガスについての吸収線幅の測 定結果⁽⁹⁾とAndersonの理論式⁽⁰⁾からaP-(4,3)線は53MHz/torrの圧力広がり率をもつこ とが計算できる。ガス圧力を70 torrから10 torrまで変化させてこの線幅の変化を測定した結 果を図-3.5.3 に示す。図中の実線は理論値を表わしている。この図から、ガス圧力を減少しても測 定された吸収線幅は約 0.3 cm⁻¹で一定となり、圧力減少に伴う線幅の減少は観測できなかった。この ような結果の生じた原因は、SFRレーザーの発振線幅が 0.3 cm⁻¹程度の広がりをもつことによる と考えられる。





図 - 5.3.4 a P-4 線吸収スペクトルのガス圧力による変化

SFRレーザー出力光の線幅が広が る原因としては

- 1) 複数の縦モードが同時に発振する
- 2) 波長 sweep 中に縦 モード間で発 振周波数のとびが生じる等の原因 が考えられる。

2)の現象が生じるためには共振器縦モ ード間隔 $4 \int_C n \bar{n} = v - \pi r d \bar{n} = r d f r d f r d \bar{n} = v - \pi r d \bar{n} = r d \bar{n} =$



共振器縦モード間隔 0.1 3 cm⁻¹ (共振器長 8 mm)に対応した二つのピークが観測される。(図 - 5. 3.6) 一方,共振器モード間隔は約 0.2 5 cm⁻¹であるため発振線幅の広がりの原因としては 2)よりはむ しろ 1)の原因が考えられる。



以上述べた事からSFRレーザーの発振線幅を狭くするためには、ラマン利得幅 Γ_{s} を減少させることが必要になるが、ラマン利得幅はこの実験で使用した磁場と光軸の配置では伝導帯のnonparabolicityによって制限され、共振器の伝導電子密度の減少と共に狭くなることが知られている。⁽²⁾ 従って、ラマン利得幅を減少させるためには伝導電子密度を減少させればよいことになるが、ラマン利得は電子密度に比例するため、利得は電子密度の減少に伴って減少するようになる。 実際に、伝導電子密度 6×10^{15} cm⁻³の共振器では Γ_{s} は0.16 cm⁻¹程度になることが報告されているが、共振器長 5 mm程度では利得が小さいため、波長 10 μ m領域でレーザー発振を実現することは困難と考えられる。⁽³⁾ 従って、低電子密度の共振器を用いた時には共振器長を少くとも 10 mm以上と長くする必要があると考えられる。

一方、共鳴効果による利得の増大を活用できる場合には伝導電子密度を減少させることが可能で ある。実際、 $CO \nu$ ーザー励起の $n - I n S b S F R \nu$ ーザーでは 10^{15} cm⁻³ の電子密度をもつ共振器で $1 k H_2$ 以下の発振器線幅が実現されている。⁽⁴⁾

以上述べたように、この実験で用いたような伝導電子密度 10^{16} cm⁻³ 程度の共振器では発振線幅 が広くなるため、ガス分子等の超高分解能分光用光源としては適当でないと考えられる。しかし、 このレーザーでは1 kWにも達する大きなビーク出力が得られるので大出力を必要とする分野への応 用が期待できる。このような分野としては、レーザー同位体分離がある。その一例として、UF₆ は波長 16μ m領域に赤外光吸収帯をもつ事が知られているが、この波長領域は光励起NH₃ガスレ ーザーによってSFRレーザーを励起することによりカバーし得ることが示されている。⁽⁵⁾また、 SFRレーザーの高出力と同調性とを利用してNH₃ガスの特定の準位を励起し、遠赤外光を発生する事 も可能と考えられる。

§ 5.4 結 言

- CO₂レーザー励起のn-InSbSFRレーザーにより 周波数854cm⁻¹から874cm⁻¹の 間に存在するNH₃ガスの吸収スペクトルを測定した。
- 2) SFRレーザーの発振線幅は約0.3 cm⁻¹である。この発振線幅の広がりはSFR利得幅が広いため、2つ以上の共振器縦モードが同時に発振するため生じると考えられる。このレーザーの単一縦モード発振は共振器の伝導電子密度を減少することにより実現できると考えられる。しかし、ラマン利得は伝導電子密度の減少と共に小さくなるため、同時にレーザーの共振器長を長くすることが必要と考えられる。
- 3) 伝導電子密度 10⁵ cm⁻³程度の InSb で構成したパルス発振 SFR レーザーではピーク出力は1 kW にも達する。従って、このレーザーは狭い発振線幅を必要とする分野よりはむしろ大出力を必要とする分野へ応用することが適当と考えられる。

参考文献

- G.Herzberg; 'Molecular Spectra and Molecular Structure' vol. 1 and 2 (D.Van Nostrand Co., New York, 1950).
- H.J.Gerriten; ' Physics of Quantum Electronics ' (ed. P.L.Kelly et al., McGraw-Hill, New York, 1966)
 p. 581.
- 3) E.D.Hinkley; Appl. Phys. Letters 16 (1970) 351.
- C.K.N.Patel, E.D.Shaw and R.J.Kerl; Phys. Rev. Letters 25 (1970) 8.
- 5) C.F.Dewey Jr. and L.O.Hocker; Appl. Phys. Letters <u>25</u> (1971) 58.
- I.M.Beterov, V.P.Chebotayev and A.S.Provorov;
 Opt. Commun. <u>7</u> (1973) 410.
- 7) C.K.N.Patel; Appl. Phys. Letters <u>25</u> (1974) 112.
- J.S.Garing, H.H.Nielsen and K.Narahari Rao; J. Mol. Spect. <u>3</u> (1959) 496.
- 9) E.D.Hinkley, K.W.Nill and F.A.Blum; 'Laser Spectroscopy of Atom and Molecules' (ed. H.Walther, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1976) p. 164.
- 10) C.H.Townes and A.L.Schawlow; 'Micrwave Spectroscopy'
 (Dover Publications Inc., New York, 1975) p. 355.
- 11) C.K.N.Patel and E.D.Shaw; Phys. Rev. <u>3</u> (1971) 1279.
- S.R.J.Brueck and A.Mooradian; Opt. Commun. <u>8</u> (1973)
 263.
- B.Walker, G.W.Chantry, D.G.Moss and C.C.Bradley;
 J. Phys. <u>D9</u> (1976) 1501.
- 14) C.K.N.Patel; Phys. Rev. Letters 28 (1972) 649.

15) C.K.N.Patel, T.Y.Chang and V.T.Nguyen; Appl. Phys. Letters <u>28</u> (1976) 603.

第6章 結 論

SFRレーザーの開発を目的とし、TECO₂レーザーを励起光源とするn-InSb及び $n-Pb_{0.88}$ Sn_{0.12}Te SFRレーザーの発振特性とn-InSbSFRレーザー出力の時間変化の測定を行ない、 その結果について考察を行なった。また、n-InSbSFRレーザーの応用を調べるためNH₃ガスの 吸収スペクトルを測定し、このレーザーの性能と問題点を明らかにした。以下で第2章から第5章 までの結果を総括し、本論文の結論とする。

- n-InSb SFRレーザーの発振開始励起しきい値強度は約0.5MW・cm⁻²であり、ピーク出力は 約1.2kWである。また、単位磁場当りの周波数同調率は約2 cm⁻¹・kG⁻¹である。
- 2) n-InSbSFRレーザーのストークス光出力は磁場約30kGから観測され始め、磁場の増加と 共にいくつかのビークを伴いながら増大し、45kGで最大となった後減少する。ラマン遷移の 始状態と終状態の間の電子分布差の磁場依存性と高次サイクロトロン共鳴吸収による吸収損失 の磁場依存性を考慮することによって、実験結果を説明した。
- n-Pb0.88Sn0.12Te SFRレーザーを初めて実現し、その発振特性を調べた。 ストークス光 出力の発振開始励起しきい値は、約 0.6 MW・cm⁻²であり、ピーク出力は約 6.6 mWである。
 また、単位磁場当りの同調率は約 2.6 5 cm⁻¹kG であり、n-InSb の約 1.3 倍である。
- 4) n-Pb0.88Sn0.12Te SFRレーザー出力の励起光周波数依存性を調べ、共鳴効果による利得の増大が存在する事を確めた。また、ストークス光出力の励起光波長依存性は励起光吸収係数と共鳴係数の変化を考慮することにより定性的に説明できる。
- 5) n-Pb0.88Sn0.12Te SFRレーザーではストークス光出力は磁場5kGから観測され、16kG でピークとなる。この出力の増大はラマン遷移の始状態と終状態間の電子分布差の増加によっ て生じると考えられる。また、磁場16kG以上での出力の減少は共鳴係数の減少による利得の 低下及び高次のサイクロトロン共鳴吸収の発生による光吸収損失の増加によると思われる。
- 6) n-InSbSFRレーザー出力及び励起光の共振器透過光にみられる過渡的な吸収を励起波長及び磁場の関数として調べ、正孔の吸収断面積が電子に比べ非常に大きい事実と、光電導度の測定結果を考え合わせることにより、この吸収は励起光が共振器中に生成した正孔によって自らが吸収されて生じることがわかった。
- 7) p-InSbを用いて温度10Kで正孔が波長10μm領域の光に対して持つ吸収断面積を初め て測定し、吸収断面積が3.4×10⁻¹⁴ cm²で、伝導電子の1400倍程度であることを明らか にした。

- 8) CO₂レーザー光入射時にn-InSbが示す光電導度を温度10Kで測定し、2光子励起過程 によってキャリアの励起が生じることを指摘した。
- 9) n InSbSFRレーザーを用いてNH₃ガスの吸収スペクトルを測定し、 NH₃ガス吸収ス ペクトル線幅のガス圧力依存性の測定から、SFRレーザー線幅は 0.3 cm⁻¹ 程度に広がって いることがわかった。 この線幅の広がりは2本程度の縦モードが同時に発振することによ り生じている。
- 10) TECO₂ レーザー励起 n InSb SFR レーザーは狭い発振線幅を必要とする高分解能分光より はむしろ大出力を必要とする分野へ応用することが適当と考えられる。

謝 辞

本論文を結ぶにあたり、本研究過程で常に暖かい御指導と御鞭撻を賜わりました電気工学教室 犬石嘉雄教授に深く感謝の意を表します。

本研究遂行中、常に実験、論文作成面で数々の貴重な御教示と御討論をいただいた電気工学教室白藤純嗣助教授に心より感謝いたします。

筆者が大阪大学大学院工学研究科在学中、種々の御指導を賜りました電気工学教室木下仁志教 授、西村正太郎名誉教授、山中千代衛教授、故川辺和夫教授、藤井克彦教授、鈴木胖教授、横山 昌弘教授、中井貞夫教授、応用物理学教室三石明善教授に深く感謝致します。

本研究で用いた光学実験装置及び低温実験装置について種々の貴重な御助言と御検討を賜りま した大阪大学低温センター吹田分室山本純也助手に心から感謝致します。超電導マグネットの使 用にあたっては、献身的な御協力をいただいた低温センターの職員の皆様に深く感謝致します。

本研究を行うにあたり、多大の御協力をいただいた電気工学教室吉野勝美助教授、井上正崇助 手、田口常正助手、金藤敬一助手をはじめ犬石研究室の諸氏に心から感謝致します。

本論文を書上げる途上で、暖かい激励をいただいた株式会社富士通研究所半導体研究部門三杉 隆彦部門長、光半導体研究部太宰浩一部長、遠山嘉一部長代理、桜井照夫第二研究室長、金田隆 夫主任研究員をはじめ光半導体研究部第二研究室の皆様に感謝致します。

本論文の校正と手続書類の清書を引き受けていただいた吉井千恵嬢に感謝致します。 最後に、本研究の完成には両親と兄弟の援助があったことを記して感謝する。

研究業績

学会誌掲載論文

1) Variation of Stokes Output with Magnetic Field in InSb Spin-Flip Raman Laser Japanese Journal of Applied Physics 16 (1977) 1075. InSb スピンフリップラマンレーザーの発振特性 2) 応用物理 46 (1977) 943. 3) Stimulated spin-flip Raman scattering in a Pb_{0.88}Sn_{G.12}Te single crystal Applied Physics Letters 34 (1979) 661. 4) Characteristics of n-Pb_{0.88}Sn_{0.12}Te Spin Flip Raman Laser Pumped by a TE CO_2 Laser Japanese Journal of Applied Physics 19 (1980) 1135. 5) Nonlinear Optical Transmission of CO₂ Laser Light in InSb at Low Temperature Japanese Journal of Applied Physics (投稿中) その他の発表論文 1) Chracteristics of InSb Spin-Flip Raman Laser Pumped by a TE CO, Laser Technology Reports of Osaka University

<u>26</u> (1976) 437.

学会講演

- スピンフリップラマンレーザーによる高分解スペクトロスコピー(I)
 応用物理学会
 早稲田大学 昭和51年3月
- スピンフリップラマンレーザーによる高分解スペクトロスコピー(II)
 応用物理学会 東北大学 昭和51年10月
- 3) InSbスピンフリップラマンレーザーの特性とガス分析への応用 電子通信学会 大阪大学 昭和51年11月 光電波部門全国大会
- 4) スピンフリップラマンレーザーによる高分解スペクトロスコピー(III)
 応用物理学会 慶応大学 昭和52年3月
- 5) スピンフリップラマンレーザーによる高分解スペクトロスコピー(N) 応用物理学 岡山大学 昭和52年10月
- 6) スピンフリップラマンレーザーの発振特性
 電気関係5学会関西支部 大阪市大 昭和52年11月
- 7) スピンフリップラマンレーザーによる高分解スペクトロスコピー(♡)
 応用物理学会 武蔵工大 昭和53年3月
- 8) n I n S b におけるCO₂ レーザー光吸収の時間的変化
 応用物理学会 学習院大 昭和54年3月
- 9) n-Pb_{0.88}Sn_{0.12}Te スピンフリップラマンレーザーの発振特性
 応用物理学会
 学習院大
 昭和54年3月
- 10) n I n S b における CO₂ レーザー光吸収の時間的変化(II)

応用物理学会 北海道大 昭和54年10月